การกำนวณพฤติกรรมของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์

นายณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ

# สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### SIMULATION OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE BEHAVIOR FOR APPLICATION IN BIOSENSORS

Mr. Nattajak Siribanluoewut

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Electrical Engineering Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2006 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การคำนวณพฤติกรรมของควอตช์คริสตัลไมโครบาลานซ์เพื่อประยุกต์ใช้
	งานด้านไบโอเซนเซอร์
โดย	นายณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ คร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> M คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ คร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Jale เอรอง ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ คร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ)

มาก อไอ้ยากอร่าง อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ คร.มานะ ศรียุทธศักดิ์)

In d\_\_\_\_\_\_nssuns

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ทับทิม อ่างแก้ว)

At OSlotus nssuns

(รองศาสตราจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์)

ณัฐจักษ์ สริบันลือวุฒิ : การกำนวณพฤติกรรมของควอตซ์กริสตัลไมโกรบาลานซ์เพื่อ ประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์. (SIMULATION OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE BEHAVIOR FOR APPLICATION IN BIOSENSORS) อ. ที่ปรึกษา : รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์, 80 หน้า.

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและจำลองการทำงานของ Quartz Crystal Microbalance (QCM) ด้วยปรากฎการณ์เพียโซอิเล็กทริก โดยใช้โปรแกรมไฟในต์เอลิเมนต์ COMSOL โดยได้ทำ การเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ QCM ที่มีมาในอดีต พบว่ามีความสอดคล้องกัน แบบจำลองที่ ได้ทำการศึกษาในงานวิจัยนี้กือ ผลของรัศมีอิเล็กโทรด ผลของตำแหน่งต่างๆในการวางมวลลงบน QCM ผลของการที่มีมวลมาเกาะแบบไม่สม่ำเสมอบน QCM ที่มีต่อความถี่เรโซแนนซ์ และผลของ การเปลี่ยนขนาดแรงคันไฟฟ้าที่มีต่อการสั่นของ QCM

พบว่าความถี่เร โซแนนซ์จะมีค่ามากขึ้นเมื่อมีรัศมีอิเล็ก โทรคที่น้อยลง จึงควรออกแบบ QCM ให้มีรัศมีอิเล็ก โทรคที่น้อยเพื่อเพิ่มความไวในการวัดตามสมการของ Sauerbrey

ความถี่เร โซแนนซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก เมื่อมวลอยู่ที่บริเวณตรงกลางอิเล็ก โทรคและมีค่า เปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อมวลอยู่ห่างจากกึ่งกลางอิเล็ก โทรค จึงควรให้มวลอยู่ที่บริเวณตรงกลางอิเล็ก โทรค ของ QCM เมื่อใช้งานเป็นไบโอเซนเซอร์เพื่อจะได้ควบคุมให้ได้การเปลี่ยนแปลงความถี่ที่เท่ากันและ ความไวในการวัคสูง

เมื่อเพิ่มขนาดของแรงคันไฟฟ้าจะทำให้การเกลื่อนตัวที่ผิวของ QCM มีก่ามากขึ้น จึงกวรป้อน แรงคันไฟฟ้าที่ไม่มากเกินไปเพื่อลดโอกาสการหลุดของโมเลกุลสาร

ในกรณีของการเกาะของมวลหากการเกาะในชั้นแรกมีน้อยแล้วการเกาะในชั้นต่อไปมีมาก ใน ลักษณะรูปตัว T หรือปีระมิคกลับค้าน ถ้ามวลมีก่าวัสดุกล้ายทอง ความถี่เรโซแนนซ์ที่วัดได้จะมีก่า ลคลงก่อนจากนั้นจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ถ้ามวลมีก่าวัสดุกล้ายโพลีสไตรีนเมื่อมวลเข้ามาเกาะความถึ่ จะลดลงไปในทิศทางเดียว

ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	 มีรับนั้ง	ว้อวชม์
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	 2020	Lonord
ปีการศึกษ	1		1

#### ##4770528321 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING

#### KEY WORD: QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE (QCM) / AT-CUT / FINITE ELEMENT METHOD (FEM)

MR.NATTAJAK SIRIBANLUOEWUT : SIMULATION OF QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE BEHAVIOR FOR APPLICATION IN BIOSENSORS . THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. MANA SRIYUDTHSAK, Ph.D., 80 pp .

This thesis presents the study and simulation of piezoelectric effect on Quartz Crystal Microbalance(QCM) using finite element program namely COMSOL. First, the QCM behaviors have been simulated comparing with the theoretical model. It was found that the simulation results are corresponded to the theoretical one. Then, the effect of electrode size, mass position on QCM, non-uniform mass, and bias-voltage on QCM's vibration have been investigated.

It was found that the resonance frequency increases as electrode size decreases. The result suggests that the QCM's electrode should be small to increase the sensitivity of the measurement.

The simulation results also indicate that the nearer of mass to QCM center the higher sensitivity of QCM was obtained. The sensitivity of the QCM continuously decreases as the mass locates far from the center of the electrode. This implies that the mass should be put at the position close to the center of the electrode for efficiently detection of mass.

The effect of changing voltage shows that the displacement of QCM relatively increases with the voltage. The result indicates that applying high voltage to QCM might effect the attachment of molecules on the QCM surface.

Finally, the simulation of non-uniform model shows that if the property of mass attached on the QCM is the same as gold, the QCM's resonant frequency will decrease at the beginning an then increases as the mass increase, if the material property is the same as polystyrene the resonant frequency will decrease as the mass increase.

Department Electrical Engineering Student's signature Natta' ak Siribanla oewat Field of study Electrical Engineering Advisor's signature Mane Signature Academic year 2006

#### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ.คร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอย่างสูง ที่ให้ กำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือมาตลอคจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ขอขอบคุณ รศ.คร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี สำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์นี้ และ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้แก่ ศ.คร. ปราโมทย์ เคชะอำไพ ผศ.คร. ทับทิม อ่างแก้ว รศ. กฤษคา วิศวธีรานนท์ รศ. คร. มานะ ศรียุทธศักดิ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าและกรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกำวิจารณ์และกำแนะนำในวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าอันมีค่ายิ่ง และขอขอบคุณนายเอนก วุฒยวนิช นส.สาริณี อุ่ยตระกูล นส.ธนิกานต์ ศิริพูลศฤงฆ์ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของ ห้องปฏิบัติการวิจัยไบโออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี มาโดยตลอค และสุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว ญาติพี่น้องและเพื่อนๆทุก คนที่คอยเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้า รวมทั้งทุนสนับสนุนของคุณพ่อ คุณแม่ ทุนจากห้องปฏิบัติการ วิจัยไบโออิเล็กทรอนิกส์ และ ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัยในการศึกษาและการทำวิจัยนี้

วิทยานิพนธ์นี้ เกิดขึ้นได้จากความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ กล่าวมาข้างต้น หากมีบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวขอบคุณไว้ ณ กิตติกรรมประกาศนี้ ข้าพเจ้าต้อง ขออภัยและขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	থ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ิจ
กิตติกรรมประกาศ	ิน
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ณ
สารบัญภาพ	<u></u>

# บทที่

1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาแล <mark>ะความสำคัญของปัญหา</mark>	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 การคำเนินการวิจัย	3
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย <u></u>	3
2 หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน	4
2.1 ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็ก <mark>ทริก</mark>	4
2.1.1 ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัล	6
2.1.2 ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริกของแผ่นควอตซ์คริสตัลแบบ AT-cut	7
2.2 สมการเชิงอนุพั <mark>น</mark> ธ์ของวัสดุเพียโซอิเล็กทริก	9
2.3 แบบจำลองที่ใช้ในการจำลอง QCM	11
2.3.1 แบบจำลอง QCM ในโปรแกรม COMSOL	13
2.4 การหาความถี่เร โซแนนซ์	18
2.4.1 การหาความถี่เร โซแนนซ์ในโปรแกรม COMSOL	
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบ	23
3.1 ทรงกระบอกเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกที่ถูกกระทำโคยโหลคคงที่	23
3.1.1 ค่าคงที่ทางวัสคุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก	24
3.1.2 ผลเฉลยแม่นตรงของ D. D. Ebenezer และ R. Ramsh	25
3.1.3 แบบจำลองในโปรแกรม COMSOL	26
3.1.4 ผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรม COMSOL	

3.2 ผลของกวามหนาที่มีต่อกวามถี่เร โซแนนซ์ของกวอตซ์แบบ AT-cut29
3.2.1 ผลเฉลยแม่นตรงของความถี่เรโซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cutใน 1 มิติ29
3.2.2 แบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ใน COMSOL แบบ 2 มิติ32
3.3 การสั่นแบบเฉือนในแนวความหนา(Thickness Shear Mode)ของควอตซ์แบบAT-cut_36
3.3.1 การสั่นทั่วบริเวณแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut36
3.3.2 การสั่นที่ผิวบนของควอตซ์แบบ AT-cut38
3.3.3 การสั่นที่บริเ <mark>วณกึ่งกลางของควอตซ์แบบ AT-cut</mark> 38
3.4 ลักษณะของคลื่นเฉือนที่เกิดขึ้นที่ควอตซ์แบบ AT-cut ที่ความถี่เร โซแนนซ <u>์</u> 39
3.5 การเปรียบเทียบผลของชั้นมวลที่ติดอยู่บนผิวของ QCM กับทฤษฎีของ Sauerbrey42
3.5.1 สมการของ Sauerbrey
3.5.2 แบบจำลองของชั้นมวลในโปรแกรม COMSOL45
3.5.3 แบบจำลองของชั้นมวล 2 ฝั่งในโปรแกรม COMSOL51
4 การคำนวณเพื่อนำ QCM ไปประยุกต์ใช้งานด้านไบ โอเซนเซอร์ <u>.</u>
4.1 ผลของขนาครัศมีอิเล็กโทรค <mark>ต่อความถี่เรโซแนนซ์</mark> 53
4.2 ผลของการเปลี่ยนบริเวณการเกาะของมวลต่อ <mark>ค</mark> วามถี่เร โซแนนซ์ของ QCM55
4.2.1ความไวในการวัดความถี่เรโซแนนซ์เมื่อมีมวลมาเกาะ
ที่ตำแหน่งต่างๆบน QCM58
4.3 การเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นบน QCM เมื่อมีการเปลี่ยนแรงคันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ QCM60
4.4 ผลของการเกา <mark>ะของมวลที่ไม่สม่ำเสมอต่อความถี่เร โซแนน</mark> ซ์ของ QCM62
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ69
5.1 สรุปผลการวิจัย69
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ70
รายการอ้างอิง71
ภาคผนวก73
ภาคผนวก ก74
ภาคผนวก ข75
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์80

# สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 2.1 ก่ากงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัล	_6
ตารางที่ 2.2 ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัลแบบ AT-cut	8
ตารางที่ 3.1 ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก	_24
ตารางที่ 3.2 ค่า total-displacement [nm] ที่จุดกึ่งกลางที่ผิวควอตซ์ เมื่อ d = 166.8 µm	
ที่ความถี่ freq = 9938000 Hz เมื่อใช้เอลิเมนต์แบบ map mesh ต่างๆกัน	_34
ตารางที่ 3.3 ค่า total-displacement [nm] ที่จุดกึ่งกลางที่ผิวควอตซ์ เมื่อ d = 166.8 µm	
ที่ความถี่ freq = <mark>9938000 H</mark> z เมื่อใช้เอ <mark>ลิเมนต์แบบสามเหลี่ยมต่างๆกัน</mark>	34
ตารางที่ 3.4 ความถี่เร โซแนนซ์ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL ใน 2 มิติ เปรียบเทียบกับความถึ่	
เรโซแนนซ์ที่ได้จากสมการที่(3.18)ใน 1 มิติ ที่ความหนาของควอตซ์ d ต่างๆกัน_	<u>35</u>
ตารางที่ 3.5 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่ 1,2,3 พร้อมทั้งแอคมิตแตนซ์ที่ได้จากโปรแกรม	
COMSOL ใช้ควอตซ์หนา d = 333.6 µm	_40
ตารางที่ 3.6 ค่าความถี่เร โซแนนซ์พร้อมทั้งค่าแอดมิตแตนซ์ ที่ความหนาทอง L ค่าต่างๆ	_47
ตารางที่ 3.7 ∆ f, ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL เทียบกับที่ได้จากสมการของ Sauerbrey	
ที่ความหนาของทอง L ต่างๆกัน	_48
ตารางที่ 3.8 ก่ากวามถี่ที่ทำให้เกิดก่า <mark>งนาดของแอดมิตแ</mark> ตนซ์สูงสุด พร้อมทั้งก่าแอดมิตแตนซ์นั่	้ัน
ที่ความหนาทอง L ต่างๆ เมื่อสแกนด้วยความละเอียดเพียง 10 Hz	_49
ตารางที่ 3.9 ก่ากวามถี่เร โซแนนซ์ที่กำนวณได้จาก COMSOL ที่กวามหนาของทองฝั่งเดียว	
และ 2 ฝั่งที่ควอตซ์หนา d = 166.8 µm	_52
ตารางที่ 4.1 ความถี่เร โซแนนซ์ และแอคมิตแตนซ์สูงสุด ของควอตซ์แบบ AT-cut	
เมื่อมีรัศมีอิเล็กโทรคต่างๆกัน	_54
ตารางที่ 4.2 ความถี่เร โซแนนซ์พร้อมทั้งค่าแอคมิตแตนซ์สูงสุด เมื่อใส่ทองที่ตำแหน่งต่างๆ	
บน QCM	_57
ตารางที่ 4.3 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปลี่ยนความหนาของทอง	
ที่มาเกาะบนตำแหน่งต่างๆที่ผิวของ QCM	_58
ตารางที่ 4.4 ความถี่เร โซแนนซ์ และการกระจัด ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของผิวบนของควอตซ์	
แบบAT-cut เมื่อเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับอิเล็กโทรด	<u>61</u>
ตารางที่ 4.5 ก่ากวามถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ทองเป็นวัสคุมวลรูปตัว T	
ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM	_64

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 4.6 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้โพลีสไตรีนเป็นวัสคุมวลรูปตัว T	
ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM	_65
ตารางที่ ข1 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ค่าวัสดุต่างๆเป็นวัสดุมวลรูปตัว T	
ที่ความกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM	_76
ตารางที่ ข2 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ <mark>ยนแปลงไปเมื่อ</mark> ใช้ทองเป็นวัสคุมวลรูปตัว T	
เมื่อแต่ละชั้นของท <mark>องหนา 834 A<sup>0</sup> และ 8340 A<sup>0</sup> ที่ความกว้างชั้นบน A</mark>	
(รูปที่ 4.11) ต่า <mark>งๆกัน</mark>	78



# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 1.1 QCM	1
รูปที่ 1.2 ระบบวัคความถี่เร โซแนนซ์ของ QCM	2
รูปที่ 2.1 รูปแบบการตัดผลึกควอตซ์ให้ได้ AT-cut	7
รูปที่ 2.2 การใช้ระบบแกนใหม่ x'y'z' เพื่อช่วยในการคำนวณควอตซ์แบบ AT-cut	7
รูปที่ 2.3 การจำลอง QCM ใน 3 มิติให้เหลือเป็น 2 มิติ	11
รูปที่ 2.4 แบบจำลองของ QCM ใน 2 มิติ	13
รูปที่ 2.5 การใส่ค่าวัสคุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์แบบ AT-cut ในโปรแกรม COMSOL	14
รูปที่ 2.6 เมตริกซ์ค่าคงที่ <mark>ทางวัสดุเพีย โซ</mark> อิเล็กทริกของควอตซ์แบบ AT-cut	
โดยตัวแปร omega_pps คือความถี่เชิงมุม <i>@</i>	14
รูปที่ 2.7 การใส่ค่าวัสดุที่ชั้นมวล	15
รูปที่ 2.8 การกำหนดหมายเลขขอบเขตของ QCM	16
รูปที่ 2.9 การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตของ QCM	16
รูปที่ 2.10 การกำหนดตัวแปรความถี่ freq ให้เป็นตัวเดียวกัน ทั้งในโหมด	
piezo plane stress(pps) และในโหมด plane stress(ps)	17
รูปที่ 2.11 การแก้ปัญหาผลต <mark>อบสนองเชิงความถี่</mark> (frequency response) โดยใช้	
parametric solver หาผลตอบในแต่ละความถี่ freq	18
รูปที่ 2.12 การอินทิเกรตกระแสไฟฟ้าเชิงผิวที่บริเวณอิเล็กโทรคบนทั้งหมด	20
รูปที่ 2.13 กราฟขนาดของกระแสไฟฟ้า abs(I) ในแต่ละความถี่ freq	
พร้อมทั้งกา <mark>รห</mark> าความถี่ freq ที่ทำให้เกิดค่า abs(I) สูงสุด	21
รูปที่ 2.14 การหาค่าความถี่ freq(9938476.0) ที่ทำให้เกิดค่า abs(I) สูงสุด(5.2757263)	22
รูปที่ 3.1 โมเคลของทรงกระบอกเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก	24
รูปที่ 3.2 เมตริกซ์ค่าคงที่ทางวัสคุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก	25
รูปที่ 3.3 ทรงกระบอกที่ถูกจำลองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม COMSOL	26
รูปที่ 3.4 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการกระจัดในแนวแกน z	27
รูปที่ 3.5 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการกระจัดในแนวรัศมี r	28
รูปที่ 3.6 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของศักย์ไฟฟ้า	28
รูปที่ 3.7 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการกระจัดทางไฟฟ้า	
ในแนวแกน z	29

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 3.8 การเคลื่อนที่แบบเฉือนในแนวความหนา (thickness shear mode)	
ของควอตซ์ AT-cut	30
รูปที่ 3.9 ควอตซ์ใน 2 มิติซึ่งถูกจำลองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยแกน y เป็นแนวความหนา d	
ในโปรแกรม COMSOL	33
รูปที่ 3.11 การกระจัดในแนวแกน x ของแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อมีความหนา d = 166.8 μ	lm
ที่กวามถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz	36
รูปที่ 3.12 การกระจัดในแนวแกน y ของแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อมีความหนา d = 166.8 μ	lm
ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz	37
รูปที่ 3.13 ทิศทางการกระจัครวม ของแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อมีความหนา d = 166.8 μm	
ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz	37
รูปที่ 3.14 การกระจัดในแนวแกน x และแกน y ที่ผิวบนของควอตซ์แบบ AT-cut	
เมื่อความหนาของควอตซ์ d = 166.8  µm  ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz	38
รูปที่ 3.15 การกระจัดในแนวแกน x และแกน y ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของควอตซ์แบบ AT-cut	
เมื่อความหนาของควอตซ์ d = 166.8  µm  ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz	39
รูปที่ 3.16 กราฟขนาดของแอดมิต <mark>แตซ์เทียบกับความถ</mark> ี่ของควอตซ์แบบ AT-cut	
ที่ความหนาd=333.6µm	40
รูปที่ 3.17 การกระจัดในแนวแกน x ที่ตำแหน่งกึ่งกลางควอตซ์แบบ AT-cut ที่แพร่ไปในแนว	
ความหนา (แกน y) เมื่อควอตซ์หนา d=333.6 µm ที่ความถี่ฮาร์ โมนิกที่ 1	
ค่าสูงสุดของการกระจัดในแนว x คือ 603.05 nm	41
รูปที่ 3.18 การกระจัดในแนวแกน x ที่ตำแหน่งกึ่งกลางควอตซ์แบบ AT-cut ที่แพร่ไปในแนว	
ความหนา (แกน y) เมื่อควอตซ์หนา d=333.6 µm ที่ความถี่ฮาร์ โมนิกที่ 3	
ค่าสูงสุดของการกระจัดในแนว x คือ 10.041 nm	41
รูปที่ 3.19 การกระจัดในแนวแกน x ที่ตำแหน่งกึ่งกลางควอตซ์แบบ AT-cut ที่แพร่ไปในแนว	
ความหนา (แกน y) เมื่อควอตซ์หนา d=333.6 µm ที่ความถี่ฮาร์ โมนิกที่ 5	
ค่าสูงสุดของการกระจัดในแนว x คือ 0.53065 nm4	42
รูปที่ 3.20 การเคลือบทองที่ผิวบนของ QCM หนา L เฉพาะบริเวณอิเล็ก โทรค4	43
รูปที่ 3.21 วงจรสมมูลของ QCM ก่อนและหลังมีมวลมาเกาะที่ผิวอิเล็กโทรค	44
รูปที่ 3.22 กราฟแอคมิตแตนซ์ของ QCM ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมี mass loading4	45

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 3.23 แบบจำลองของ QCM ที่มีชั้นทองหนา L เคลือบอยู่ที่ผิวอิเล็ก โทรค	_46
รูปที่ 3.24 ค่าวัสดุของทองที่ใส่ในโปรแกรม COMSOL	_46
รูปที่ 3.25 กราฟ ∆ f, ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL เทียบกับที่ได้จากสมการของ Sauerbrey	
ที่ความหนาของ L ต่างๆกัน	_48
รูปที่ 3.26 กราฟขนาคของแอคมิตแตนซ์เมื่อเกิ <mark>ค mass</mark> loading ของชั้นทองที่ความหนา L	
ต่างๆกัน เมื่อสแกนละเอียดถึง 1 Hz	_50
รูปที่ 3.27 รูปแบบการเคลือ <mark>บมวลยูนิฟอ</mark> ร์ม 2 ฝั่งแบบต่างๆ	_51
รูปที่ 4.1 ควอตซ์ใน 2 มิติซึ่งถูกจำลองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแปรก่ารัศมีอิเล็กโทรด r	
ในโปรแกรม COMSOL	_54
รูปที่ 4.2 กราฟความถี่เร โซแนนซ์เมื่อแปรค่ารัศมีอิเล็ก โทรด r	_55
รูปที่ 4.3 ตำแหน่งการใส่ทองบนผิวของ QCM	_56
รูปที่ 4.4 การวางทองแบบยูนิฟอร์มขนาดเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรดและหนา 41.7 A°	<u>.</u> 56
รูปที่ 4.5 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับปริมาตรของทอง	
เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบการเกาะ	_59
รูปที่ 4.6 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที <mark>่เปลี่ยนแปลงไปเทีย</mark> บกับตำแหน่งต่างๆ บน QCM	
เมื่อเปลี่ยนความหนาของทอง <u></u>	_59
รูปที่ 4.7 ควอตซ์ใน 2 มิติซึ่งถูกจำลองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแปรค่าแรงคันไฟฟ้าที่ป้อน	
ให้กับอิเล็กโทรค 🗛 ในโปรแกรม COMSOL	_60
รูปที่ 4.6 กราฟการกระ <mark>จัด</mark> รวมที่ตำแหน่งกึ่งกลางผิวบนของควอ <mark>ต</mark> ซ์เทียบกับแรงดันไฟฟ้า	
ที่ป้อนให้กับอิเล็กโทรค	_61
รูปที่ 4.9 โมเคลการเกาะของเซลล์เป็นรูปตัว T ที่ขยายออกไปทางค้านข้างเรื่อยๆ	_62
รูปที่ 4.10 การใส่มวลเป็นรูปตัว T บน QCM ใน 2 มิติ ในโปรแกรม COMSOL	_62
รูปที่ 4.11 มวลรูปตัว T ที่นำมาเกาะบนผิวของ QCM	_63
รูปที่ 4.12 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ทองเป็นวัสคุมวลรูปตัว T	
ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่าง ๆ กัน มาเกาะตรงกลาง QCM	_66
รูปที่ 4.13 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้โพลีสไตรีนเป็นวัสคุมวลรูปตัว T	
ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่าง ๆ กัน มาเกาะตรงกลาง QCM	_66
รูปที่ 4.14 กราฟแสดงค่าการกระจัดทางแกน x ที่ชั้นบนของทองรูปตัว T เทียบกับแกน x	
ที่ความถี่เร โซแนนซ์ เมื่อความกว้างของชั้นบนของตัว T,A=1.4 mm	<u>.</u> 67

କୁ

#### ภาพประกอบ

รูปที่ 4.15 กราฟแสดงค่าการกระจัดทางแกน x ที่ชั้นบนของโพลีสไตรีนรูปตัว T เทียบกับแกน x ที่ความถี่เร โซแนนซ์ เมื่อความกว้างของชั้นบนของตัว T,A=1.4 mm\_\_\_\_\_67 รูปที่ ข1 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้วัสดุที่มีค่า E=78e9 N/m<sup>2</sup>,V=0.44 ,*Q*=1050 kg/m<sup>3</sup> มาเป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างชั้นบน A(รูปที่4.11)ต่างๆกัน\_\_\_\_77 รูปที่ ข2 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้วัสดุที่มีค่า E=3.17e9 N/m<sup>2</sup>,V=0.44 ,*Q*=19300 kg/m<sup>3</sup> มาเป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างชั้นบน A(รูปที่4.11)ต่างๆกัน\_\_\_\_77 รูปที่ ข3 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้กองที่แต่ละชั้นหนา 8340 A<sup>0</sup> เป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างชั้นบน A (รูปที่4.11) ต่างๆกัน\_\_\_\_\_79

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า

บทที่ 1

#### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ควอตซ์กริสทัลไมโกรบาลานซ์( quartz crystal microbalance: QCM) เป็นทรานส์ดิวเซอร์ ตรวจวัดมวลชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจวัดมวลขนาดเล็กได้ถึงระดับนาโนกรัม ผลึกควอตซ์ที่นิยม ใช้ได้แก่ ผลึกชนิด AT-cut เนื่องจากเป็นผลึกที่มีสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิต่ำที่ อุณหภูมิห้อง ในการใช้งานนั้นก็มีเพียงวงจรออสซิเลเตอร์และวงจรวัดก็เพียงพอต่อการทำงาน จึง ง่ายต่อการจัดหา และไม่ยุ่งยากเหมือนระบบการวัดแบบอื่นๆ เช่น ระบบวัดที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า เกมี หรือทางแสง เป็นต้น



รูปที่ 1.1 QCM

ในปัจจุบัน แนวโน้มของการใช้ QCM เป็นไบโอเซนเซอร์มีสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก ระบบวัดมีราคาถูก จัดหาได้ง่าย หลักการวัดโดยใช้ QCM นั้นเข้าใจง่ายกว่าระบบตรวจวัดแบบ อื่นๆ กล่าวคือเมื่อเกิดการจับกันระหว่างสารชีวภาพที่ต้องการตรวจวัด กับผิวของ QCM ก็จะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของความถี่เรโซแนนซ์ของ QCM ขึ้น ซึ่งสามารถตรวจวัดได้โดยใช้วงจรวัด ความถี่ดังรูปที่ 1.2 หรือสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์ (Impedance Analyzer) การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการสั่นของผลึกควอตซ์ที่ เปลี่ยนไปนั่นเอง



รูปที่ 1.2 ระบบวัคความถี่เร โซแนนซ์ของ QCM

อีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถนำ QCM มาใช้เป็นไบโอเซนเซอร์ได้ก็คือ QCM มีความไวในการ วัดสูง คือมีการตอบสนองต่อโมเลกุลเล็กๆที่มาเกาะบนพื้นผิวได้ ทำให้เหมาะต่อการใช้งานในการ วัดโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น DNA เป็นต้น

ในการวิเคราะห์การสั่นของ QCM ในกรณีที่นำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆนั้น การใช้วิธี วิเคราะห์(Analytical) หรือการหาผลเฉลยโดยตรงนั้นทำได้ยาก และไม่เห็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะต้องแก้สมการอนุพันธ์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในกรณีของรูปทรงวัสดุที่ไม่สมมาตร หากต้องการแก้สมการให้ง่ายขึ้นก็ต้องตัดตัวแปรบางตัวทิ้งไป ซึ่งทำให้ผลเฉลยที่ได้ออกมา ผิดพลาดได้

ในวิทยานิพนธ์นี้จึงได้เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาเชิงตัวเลขคือ ไฟในต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) มาทำการหาผลเฉลยของ QCM ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งวิธีไฟในต์เอลิเมนต์เป็นที่นิยมใช้กัน มากในปัจจุบัน เพราะมีผู้ผลิตออกมาเป็นซอฟท์แวร์จำนวนมาก และสามารถหาผลเฉลยของ รูปทรงที่ซับซ้อนได้ โดยซอฟท์แวร์ทางไฟในต์เอลิเมนต์ที่ได้เลือกใช้ในงานวิจัยนี้คือโปรแกรม COMSOL ที่สามารถใช้คำนวณวัสดุทางเพียโซอิเล็กทริกได้

การจำลอง QCM โดยใช้ไฟในต์เอลิเมนต์ มีการทำมาแล้วพอสมควร คือ การใช้ไฟในต์เอ ลิเมนต์เพื่อจำลองหารูปร่างของควอตซ์ (รัศมี ความหนา ลักษณะอิเล็กโทรค) เพื่อให้ได้ค่าคุณภาพ (Q-factor) สูงสุค[1] , การใช้ไฟในต์เอลิเมนต์คำนวณความถี่เรโซแนนซ์ของ QCM ในการวัค ปริมาณก๊าซ ใน Gas Sensor[2], การใช้ไฟในต์เอลิเมนต์เพื่อดูการเคลื่อนที่ในการสั่นของ Quartz ที่ ความถี่เรโซแนนซ์[3], การใช้ไฟในต์เอลิเมนต์เพื่อดูผลจากการที่ใช้อิเล็กโทรดคู่ใน QCM[4] เป็น ต้น

อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจของ QCM ที่ยังไม่ได้ทำการจำลอง วิทยานิพนธ์นี้จึงได้มุ่งประเด็นที่ การนำผลการจำลองเพื่อไปช่วยในการทดลองด้านไบโอเซนเซอร์ เช่นศึกษาผลของมวลที่เกาะลงบนควอตซ์ที่ตำแหน่งต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อความถี่เรโซแนนซ์ การ กระจายตัวของสนามไฟฟ้าบริเวณอิเล็กโทรด ความแรงของการสั่นที่ส่งผลกระทบต่อโมเลกุลที่ผิว ซึ่งสามารถนำไปช่วยออกแบบและอธิบายผลการทดลองให้ดีขึ้นได้

#### 1.2 วัตถุประสงค์

- 1. ใช้ไฟในต์เอลิเมนต์ จำลอง ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบน QCM
- นำผลที่ได้จากการจำลองไปใช้ในการออกแบบ QCM เพื่อใช้ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

#### 1.3 ขอบเขตการวิจัย

1. ออกแบบและจำลองปรากฏการณ์สั่นที่เกิดขึ้นบน QCM แบบAT-cut โดยวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์

- 2. จำลองปรากฏการณ์สั่นที่เกิดขึ้นบน QCM เมื่อมีโมเลกุลของสารอยู่บนผิวในลักษณะต่างๆ
- จำลองปรากฏการณ์สั่นที่เกิดขึ้นบน QCM เมื่อมีการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ QCM

#### 1.4 การดำเนินการวิจัย

- 1. ศึกษาหลักการทำงานของ QCM และปรากฎการณ์ทางเพียโซอิเล็กทริกของ QCM
- 2. ศึกษาวิธีและ โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
- จำลองปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก และ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเพียโซอิเล็กท ริก เช่น ความเค้น(Stress), ความเครียด(Strain), การกระจัดทางไฟฟ้า(Electric Displacement), สนามไฟฟ้า(Electric Field) จากตัวอย่างที่มีผลการทดลองเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความจำนาญ ความเข้าใจ และความถูกต้องในการจำลอง
- 4. ทคลองใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับโมเคลของ QCM เปรียบเทียบกับทฤษฎี
- ดูผลของการเกาะของมวลที่ตำแหน่งต่างๆบน QCM ว่าส่งผลต่อความถี่เร โซแนนซ์อย่าง ไร คำนวณการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าบริเวณอิเล็กโทรด
- 6. จำลองการทำงานของ QCM เมื่อมีมวลมาเกาะแบบไม่สม่ำเสมอ
- วิเคราะห์และสรุปผลการจำลอง เพื่อนำไปช่วยอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้นจริง และ สามารถปรับปรุงวิธีการวัดให้ดียิ่งขึ้น

## 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ช่วยปรับปรุงวิธีการวัดและทดลอง QCM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพิ่มแนวกิดในกระบวนการวัดทาง QCM คือสามารถนำไฟในต์เอลิเมนต์มาตรวจสอบผล การทดลองให้ถูกต้องได้

### บทที่ 2

## หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และ ทฤษฎีของปรากฎการณ์เพียโซอิเล็กทริกโดยกล่าวถึง สมการทางวัสดุของเพียโซอิเล็กทริกและสมการเชิงอนุพันธ์ของเพียโซอิเล็กทริก โดยใช้วัสดุของ กวอตซ์แบบ AT-cut เป็นหลักเพราะเป็นวัสดุที่ใช้ทำเป็น QCM และกล่าวถึงสมการที่แสดงลักษณะ ของชั้นมวลที่มาเกาะบนผิวของควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อรู้สมการที่อธิบายลักษณะทั้งหมดของ QCM แล้วก็จะทำการจำลอง QCM ลงบนโปรแกรม COMSOL แล้วจึงทำการหาความถี่เรโซแนนซ์ ในการสั่นของ QCM

#### 2.1 ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก

กวอตซ์เป็นวัสดุเพียโซอิเล็กทริกชนิดหนึ่ง ดังนั้น การสั่นของควอตซ์เป็นผลของ ปรากฎการณ์เพียโซอิเล็กทริก ปรากฎการณ์เพียโซอิเล็กทริกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1880 โดย Pierre Curie และ Jacques Curie ทั้ง 2 ได้ทำการทดลองวัดค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมา กระทำต่อผลึกควอตซ์ ในปีต่อมา Lippman ได้ศึกษาในทางกลับกันคือหาความเครียดในเนื้อวัสดุที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการป้อนศักย์ไฟฟ้าให้แก่วัสดุเพียโซอิเล็กทริก หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1894 Voight ได้ประยุกต์ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ของแข็งและความรู้ทางด้านไฟฟ้าสถิตย์ ในการสร้างสมการ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของวัสดุเพียโซอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกอธิบายได้ดังนี้ ในตอนแรกวัสดุจะอยู่ในสภาพสมดุล ต่อมา เมื่อเราป้อนสนามไฟฟ้า ก็จะทำให้เกิดการเรียงตัวใหม่ของโมเลกุลต่างๆ ซึ่งมีประจุบวกหรือลบ โดยประจุลบก็จะวิ่งไปหาขั้วบวก ประจุบวกก็จะวิ่งไปหาขั้วลบ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของ โมเลกุล ทำให้วัสดุยึดหรือหดตัว หรือเกิดความเค้น(Stress) ความเครียด(Strain)ขึ้นนั่นเอง ในทาง กลับกัน ถ้าออกแรงกระทำต่อวัสดุที่อยู่ในสภาพสมดุล ก็จะทำให้โมเลกุลภายในวัสดุเปลี่ยน ตำแหน่ง ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางไฟฟ้าขึ้น และเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นภายในวัสดุ

ทั้งนี้ผลตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการป้อนสนามไฟฟ้าหรือแรง จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ วัสจุด้วย กล่าวคือ ถ้าวัสจุเป็นแบบ Anisotropy (ควอตซ์ก็เป็นวัสดุชนิดนี้) เมื่อมองในทิศทางต่างๆ ของวัสจุเป็นมุมเอียงไม่เท่ากัน โครงสร้างของโมเลกุลจะแตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเราป้อนสนามไฟฟ้า ที่เท่ากัน แต่ต่างทิศกัน ผลที่ได้ออกมาจะเป็นการยืดหดตัวที่แตกต่างกัน กล่าวคือค่าคงที่ของวัสจุ (Material Constants) จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญในการคำนวณปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกทั้งแบบ สมมาตรและแบบไม่สมมาตร ดังนั้นในการใช้งานวัสอุเพียโซอิเล็กทริก จึงต้องคำนึงถึงทิศทาง และค่าคงที่วัสอุที่ใช้เพื่อให้ได้การสั่นในรูปแบบ(Mode)ที่ต้องการ ระบบสมการเพียโซอิเล็กทริก(Piezoelectric Coupled Equations)ใน 3 มิติสามารถเขียนได้ เป็น(รูปแบบ Stress-Charge Form) [5,6] ดังแสดงในสมการที่ (2.1) และ (2.2)

$$\{T\} = \begin{bmatrix} C^E \end{bmatrix} \{S\} - \begin{bmatrix} e \end{bmatrix}^T \{E\}$$
(2.1)

$$\{D\} = [e]\{S\} + [\varepsilon^{s}]\{E\}$$
(2.2)

โดย

$$\{T\} = \begin{cases} T_x \\ T_y \\ T_z \\ T_{xz} \\ T_{xx} \\ T_{xy} \end{cases} \quad \text{ilu Stress [N/m^2]} \qquad \{S\} = \begin{cases} S_x \\ S_y \\ S_z \\ 2S_{yz} \\ 2S_{xz} \\ 2S_{xy} \end{cases} \quad \text{ilu Strain [-]} \\ \{D\} = \begin{cases} D_x \\ D_y \\ D_z \end{cases} \quad \text{ilu Electric Displacement [C/m^2]} \quad \{E\} = \begin{cases} E_x \\ E_y \\ E_z \end{cases} \quad \text{ilu Electric Field [V/m]} \end{cases}$$

โดยอักษร x, y, z ที่ห้อยอยู่ เป็นตัวบ่งบอกทิศทาง

ค่าคงที่ของวัสดุ(Material Constants) มีคังต่อไปนี้

Stiffness Matrix หรือ Elastic Constant  $\begin{bmatrix} C^E \end{bmatrix}$  [N/m<sup>2</sup>] (เมื่อ Electic Field ( E ) เป็น 0)

$$\begin{bmatrix} C^E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c11 & c12 & c13 & c14 & c15 & c16 \\ c22 & c23 & c24 & c25 & c26 \\ & c33 & c34 & c35 & c36 \\ & c44 & c45 & c46 \\ S & Y & M & c55 & c56 \\ & & c66 \end{bmatrix}$$

Piezoelectric Coupled Matrix ਅਤੇ Coupling Matrix [e] [C/m<sup>2</sup>]

$$[e] = \begin{bmatrix} e11 & e12 & e13 & e14 & e15 & e16 \\ e21 & e22 & e23 & e24 & e25 & e26 \\ e31 & e32 & e33 & e34 & e35 & e36 \end{bmatrix}$$

Dielectric Matrix  $\left[ \mathcal{E}^{S} \right]$  [C/V.m](เมื่อ Stress (S) เป็น 0)

$$\begin{bmatrix} \varepsilon^{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon 11 & \varepsilon 12 & \varepsilon 13 \\ & \varepsilon 22 & \varepsilon 23 \\ SYM & & \varepsilon 33 \end{bmatrix}$$

#### 2.1.1 ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัล (Quartz Crystal)

สำหรับกรณีของ Right-handed Quartz Crystal (SiO2) จะมีก่ากงที่ของวัสคุคือ [3]

$$\begin{bmatrix} C^{E} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c11 & c12 & c13 & c14 & 0 & 0 \\ c11 & c13 & -c14 & 0 & 0 \\ & c33 & 0 & 0 & 0 \\ & c44 & 0 & 0 \\ S & Y & M & c44 & c14 \\ & & c66 \end{bmatrix}$$
   

$$\begin{bmatrix} e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e11 & -e11 & 0 & e14 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -e14 & -e11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C/m^{2} \end{bmatrix}$$
  

$$\begin{bmatrix} \varepsilon^{S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon11 & 0 \\ \varepsilon11 & 0 \\ SYM & \varepsilon33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C/V.m \end{bmatrix}$$
  
<sup>†</sup>suarosninlumnensin 2.1

# ตารางที่ 2.1 ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัล [3,5]

Elastic-constants  $[\times 10^9 \text{ N/m}^2]$ 

<i>c</i> 11	<i>c</i> 12	<i>c</i> 13	<i>c</i> 14	<i>c</i> 33	<i>c</i> 44	<i>c</i> 66
86.74	6.99	11.91	-17.91	107.2	57.94	39.875

Piezoelectic-constants [C/m<sup>2</sup>]

12	<i>e</i> 11	<i>e</i> 14
0	0.171	-0.0406
Dielectric-constants [×10 <sup>-12</sup> C/V.m]	13	19151
	<i>ɛ</i> 11	<i>ε</i> 33
จพาลงกร	39.21	41.03

#### 2.1.2 ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์คริสตัลแบบ AT-cut

ควอตซ์คริสตัล AT-cut เป็นแผ่นควอตซ์ที่เกิดจากการตัดผลึก Quartz Crystal (SiO<sub>2</sub>) เป็น มุม +35°15' เทียบกับระนาบ zx (หรือ y-cut นั่นเอง) ตามรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 รูปแบบการตัดผลึกควอตซ์ให้ได้ AT-cut [7] (หมายเหตุ AT-cut,BT-cut มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็น 0 ที่อุณหภูมิห้อง)

จะเห็นได้ว่า ถ้าเราพิจาณาแกนใหม่ (x'y'z') ที่เกิดจากการหมุนแกนโดยยึดแกน x เป็นแกน หมุน ไปเป็นมุม +35°15' จะได้ ระนาบ z'x' ขนานกับระนาบ AT-cut พอดี และแกน y' ตั้งฉากกับ ระนาบนั้นด้วย ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 การใช้ระบบแกนใหม่ x'y'z' เพื่อช่วยในการคำนวณควอตซ์แบบ AT-cut

ซึ่งเราสามารถแปลงค่าคงที่ของวัสดุให้สอดคล้องกับระบบแกนใหม่ได้ โดยคูณเมตริกซ์ การแปลง(Coordinate Transformation Matrix) [M],[a] เข้าไปในค่าคงที่เดิม ตามสูตรในสมการที่ (2.3) [2,5]

$$\begin{bmatrix} C^{E} \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C^{E} \end{bmatrix} M \end{bmatrix}^{T}, \begin{bmatrix} e' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}^{T}, \begin{bmatrix} \varepsilon^{S} \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon^{S} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \end{bmatrix}^{T}$$
(2.3)  

$$\begin{bmatrix} a e^{2} \\ a e^{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a e^{2} \\ a e^{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a e^{2} \\ a e^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a e^{2} \\ a e^{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a e^{2} \\ a e^{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a e^$$

$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta & \sin^2 \theta & \sin 2\theta & 0 & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & -\sin 2\theta & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-\sin 2\theta}{2} & \frac{\sin 2\theta}{2} & \cos 2\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$
$$[a] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{was } \theta = +35^\circ 15^\circ = +35.25^\circ$$

ซึ่งเมื่อคำนวณตามสมการที่ 2.3 จะได้ก่ากงที่ของวัสคุที่ใช้ในแกนใหม่ X'Y'Z' เป็น[1]

	c'11	c'12	c'13	<i>c</i> '14	0	0
		c'22	c'23	<i>c</i> '24	0	0
$\begin{bmatrix} C^E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C^E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}^T =$			c'33	<i>c</i> '34	0	0
	19. 20			<i>c</i> '44	0	0
	S	Y	М		<i>c</i> '55	<i>c</i> '56
						<i>c</i> '66_

$$\begin{bmatrix} e' \end{bmatrix} = [a][e][M]^T = \begin{bmatrix} e'11 & e'12 & e'13 & e'14 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & e'25 & e'26\\ 0 & 0 & 0 & 0 & e'35 & e'36 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} \varepsilon^{s} \cdot \end{bmatrix} = [a][e][a]^T = \begin{bmatrix} \varepsilon'11 & 0 & 0\\ & \varepsilon'22 & \varepsilon'23\\ & SYM & & \varepsilon'33 \end{bmatrix}$$

### ตารางที่ 2.2 ก่ากงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของกวอตซ์แบบ AT-cut [2,4,8]

Elastic-constants [10<sup>9</sup> N/m<sup>2</sup>]

c'11	c'12	c'13	c'14	c'22	<i>c</i> '23	<i>c</i> '24
86.74	-8.25	27.15	-3.66	129.77	-7.42	5.7
c'33	<i>c</i> '34	<i>c</i> '44	c'55	<i>c</i> '56	<i>c</i> '66	
102.83	9.92	38.61	68.81	2.54	29.01	

Piezoelectic-constants [C/m<sup>2</sup>]

<i>e</i> '11	<i>e</i> '12	<i>e</i> '13	<i>e</i> '14	e'25	e'26	e'35	e'36
0.171	-0.1523	-0.0187	0.067	0.1077	-0.0949	-0.0761	0.0671

<i>ɛ</i> '11	ε'22	ε'23	<i>ɛ</i> '33
39.21	39.8162	0.8578	40.4238

หรือคำนวณหาค่า Relative dielectric-constants [-] ได้เป็น

$\varepsilon_r$ '11	<i>ε</i> <sub>r</sub> '22	<i>ε</i> <sub>r</sub> '23	<i>ɛ</i> , '33
4.428	4.497	0.097	4.5657

ซึ่งการนำไปใช้ ต้องใช้แทนในสมการที่สอดคล้องกับระบบแกนใหม่ x'y'z' คือสมการที่ (2.4) และ (2.5)

$$\{T'\} = \begin{bmatrix} C^{E} \\ \end{bmatrix} \{S'\} - \begin{bmatrix} e' \end{bmatrix}^{T} \{E'\}$$
(2.4)

$$\{D'\} = [e']\{S'\} + [\varepsilon^{S'}]\{E'\}$$

$$(2.5)$$

โดย

$$\{T'\} = \begin{cases} T_{x'} \\ T_{y'} \\ T_{z'} \\ T_{y'z'} \\ T_{x'z'} \\ T_{x'y'} \end{cases}$$

$$\{S'\} = \begin{cases} S_{x'} \\ S_{y'} \\ S_{z'} \\ 2S_{y'z'} \\ 2S_{x'z'} \\ 2S_{x'y'} \\ 2S_{x'y'} \\ 2S_{x'y'} \\ 2S_{x'y'} \\ \end{bmatrix}$$

$$\{E'\} = \begin{cases} E_{x'} \\ E_{y'} \\ E_{z'} \\ \end{cases}$$

ซึ่งก่ากงที่และตัวแปรเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกวอตซ์แบบ AT-cut ได้โดยตรงในการ กำนวณ

ต่อไปในการคำนวณ เราจะตั้งแกน y ให้ตั้งฉากกับระนาบแบบ AT-cut และระนาบ zx เป็น ระนาบเดียวกับ ระนาบ AT-cut ซึ่งสามารถละทิ้งสัญลักษณ์ x', y', z' มาใช้สัญลักษณ์ธรรมดา x, y, z ได้ เพราะเราตั้งระบบแกนตรงกับค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริกที่ใช้ในการคำนวณแล้ว

#### 2.2 สมการเชิงอนุพันธ์ของวัสดุเพียโซอิเล็กทริก[9]

สมการเชิงอนุรักษ์ โมเมนตัม(Newton's law) ใน 3 มิติ คือสมการที่ (2.6)

$$\nabla \cdot T = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{2.6}$$

โดยที่

ho คือ ความหนาแน่นของควอตซ์ มีค่า 2648 [kg/m³]

เมื่อกิดเป็นผลตอบสนองเชิงกวามถี่(frequency response) จะเปลี่ยนตัวแปรทุกตัวเป็นเฟส เซอร์ (ตัดเทอมของเวลา  $\cos(\omega t)$  ทิ้ง) และเปลี่ยน  $\frac{\partial}{\partial t}$  เป็น  $i\omega$  ตามสมการที่ (2.7),(2.8),(2.9)

$$\frac{\partial T_x}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z} = -\rho\omega^2 U_x$$
(2.7)

$$\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_{y}}{\partial y} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial z} = -\rho\omega^{2}U_{y}$$
(2.8)

$$\frac{\partial T_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial T_z}{\partial z} = -\rho\omega^2 U_z$$
(2.9)

โดยที่

 $\omega$  [rad/s] คือความถี่เชิงมุม

 $T_x, T_y, T_z$  [Npeak/m<sup>2</sup>] คือเฟสเซอร์ของความเค้นตั้งฉากในแนว x, y, z ตามลำดับ  $T_{xy}, T_{yz}, T_{xz}$  [Npeak/m<sup>2</sup>] คือเฟสเซอร์ของความเค้นเฉือนในแนว xy, yz, xz ตามลำดับ  $U_x, U_y, U_z$  [m peak] คือ เฟสเซอร์ของการเคลื่อนตัวในแนว x, y, z ตามลำดับ สมการเชิงอนุรักษ์ประจุ(Guass's law)ใน 3 มิติ เมื่อความหนาแน่นประจุ ( $\rho_v$ ) เป็น 0 คือ

สมการที่ (2.10)

$$\nabla \cdot D = \rho_{v} = 0 \tag{2.10}$$

เมื่อกระจายแล้วจะใค้สมการที่ (2.11)

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho_v = 0$$
(2.11)

โดยที่

D<sub>x</sub>,D<sub>y</sub>,D<sub>z</sub> [Cpeak/m<sup>2</sup>] คือ เฟสเซอร์ของการกระจัดทางไฟฟ้าในแนว x , y , z ตามถำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเคลื่อนตัวคือสมการที่ (2.12),(2.13)

$$S_x = \frac{\partial U_x}{\partial x}, S_y = \frac{\partial U_y}{\partial y}, S_z = \frac{\partial U_z}{\partial z}$$
 (2.12)

$$S_{xy} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_x}{\partial y} + \frac{\partial U_y}{\partial x} \right), S_{yz} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_y}{\partial z} + \frac{\partial U_z}{\partial y} \right), S_{xz} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_x}{\partial z} + \frac{\partial U_z}{\partial x} \right)$$
(2.13)

โดยที่

S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub> [-] คือเฟสเซอร์ของความเครียดตั้งฉากในแนว x , y , z ตามลำคับ S<sub>xy</sub>, S<sub>yz</sub>, S<sub>xz</sub> [-] คือเฟสเซอร์ของความเครียดเฉือนในแนว xy , yz , xz ตามลำคับ ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าคือสมการที่ (2.14)

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial \phi}{\partial z}$$
 (2.14)

โดยที่

*E<sub>x</sub>*, *E<sub>y</sub>*, *E<sub>z</sub>* [Vpeak/m] คือเฟสเซอร์ของสนามไฟฟ้าในแนว x , y , z ตามลำคับ
 *φ* [Vpeak] คือเฟสเซอร์ของแรงคันไฟฟ้า

เมื่อแทนสมการ (2.4),(2.5),(2.12),(2.13),(2.14) ลงในสมการที่ (2.7),(2.8),(2.9),(2.11) จะ ได้สมการเชิงอนุพันธ์ 4 สมการ ในรูปของ 4 ตัวแปรเท่านั้นคือ  $U_x, U_y, U_z, \phi$ 

#### 2.3 แบบจำลองที่ใช้ในการจำลอง QCM

จำลองตัวควอตซ์โดยใช้โหมดเพียโซอิเล็กทริก ระนาบความเค้น (piezo plane stress) จาก ตัวคริสตัลออสซิลเลเตอร์ที่เป็นแผ่นวงกลมรัศมี 4 mm และมีรัศมีอิเล็กโทรด r ใน 3 มิติ ให้เหลือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 mm หนา d และมีอิเล็กโทรดกว้าง 2r ใน 2 มิติ และชั้นมวล (mass) จำลองโดยใช้โหมดระนาบความเค้น (plane stress) จากรูปทรง 3 มิติ ให้เป็นหน้าตัด 2 มิติ ดังแสดง ในรูปที่ 2.3 และ 2.4



รูปที่ 2.3 การจำลอง QCM ใน 3 มิติให้เหลือเป็น 2 มิติ

ระบบสมการทางวัสคุของเพียโซอิเล็กทริกใน 3 มิติ ของควอตซ์แบบ AT-cutในสมการที่ 2.4 และ 2.5 สามารถรวมกันแล้วแสดงเป็นรูปแบบเมตริกซ์ได้ดังสมการที่ (2.15)

	$\left(T_{x}\right)$		c11	<i>c</i> 12	<i>c</i> 13	<i>c</i> 14	<i>c</i> 15	<i>c</i> 16	– <i>e</i> 11	0	0 ]	$\left( S_{x} \right)$	
	$T_{y}$		<i>c</i> 12	c22	c23	c24	c25	c26	- <i>e</i> 12	0	0	$S_y$	
	$T_z$		<i>c</i> 13	<i>c</i> 23	<i>c</i> 33	<i>c</i> 34	<i>c</i> 35	<i>c</i> 36	– <i>e</i> 13	0	0	$S_z$	
	$T_{yz}$		<i>c</i> 14	<i>c</i> 24	<i>c</i> 34	<i>c</i> 44	<i>c</i> 45	<i>c</i> 46	– <i>e</i> 14	0	0	$2S_{yz}$	
<	$T_{xz}$	} =	<i>c</i> 15	c25	<i>c</i> 35	<i>c</i> 45	<i>c</i> 55	<i>c</i> 56	0	- <i>e</i> 25	- <i>e</i> 35	$\left\{2S_{xz}\right\}$	(2.15)
	$T_{xy}$		<i>c</i> 16	<i>c</i> 26	<i>c</i> 36	<i>c</i> 46	<i>c</i> 56	<i>c</i> 66	0	- <i>e</i> 26	- <i>e</i> 36	$2S_{xy}$	
	$D_x$		<i>e</i> 11	<i>e</i> 12	<i>e</i> 13	<i>e</i> 14	0	0	<i>ɛ</i> 11	0	0	$E_x$	
	$D_y$		0	0	0	0	e25	e26	0	<i>ε</i> 22	ε23	$E_y$	
	$\left[ D_{z} \right]$		0	0	0	0	e35	e36	0	ε23	<i>ε</i> 33 ]	$\left[ E_{z} \right]$	

ซึ่งสามารถจำลองเป็น 2 มิติในรูปแบบเพียโซอิเล็กทริกระนาบความเค้น (piezo plane stress) ได้โดยให้  $T_z, T_{yz}, T_{xz}, D_z, S_{yz}, S_{xz}, E_z$  เป็น 0 และตัดแถวกับหลักที่ 4,5,9 ในสมการที่ 2.15 ทิ้งไป จะได้เป็นสมการที่ (2.16)

$$\begin{cases} T_x \\ T_y \\ 0 \\ 0 \\ T_{xy} \\ D_x \\ D_y \end{cases} = \begin{bmatrix} c11 & c12 & c13 & c16 & -e11 & 0 \\ c12 & c22 & c23 & c26 & -e12 & 0 \\ c13 & c23 & c33 & c36 & -e13 & 0 \\ c16 & c26 & c36 & c66 & 0 & -e26 \\ e11 & e12 & e13 & 0 & \varepsilon11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e26 & 0 & \varepsilon22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \\ 2S_{xy} \\ E_x \\ E_y \end{bmatrix}$$
(2.16)

สมการ (2.16) นี้มีแถวที่จำเป็นต้องนำมาแก้สมการร่วมกับสมการเชิงอนุพันธ์ ก็คือแถวที่ 1,2,4,5,6 คือยกเว้นแถวที่ 3 ที่ไว้หาค่า S, เท่านั้น

สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไว้ใช้แก้ปัญหาเพียโซอิเล็กทริกใน 2 มิติ คือสมการที่ (2.17) ถึงสมการ ที่ (2.21) ( ho [kg/m³] ในซับโคเมนของควอตซ์คือ ค่าความหนาแน่นของควอตซ์)

$$\frac{\partial T_x}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} = -\rho\omega^2 U_x \tag{2.17}$$

$$\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_y}{\partial y} = -\rho\omega^2 U_y$$
(2.18)

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} = 0$$
(2.19)

$$S_{x} = \frac{\partial U_{x}}{\partial x}, S_{y} = \frac{\partial U_{y}}{\partial y}, S_{xy} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_{x}}{\partial y} + \frac{\partial U_{y}}{\partial x} \right)$$
(2.20)

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$$
(2.21)

โดยสุดท้ายเมื่อแทนสมการที่ (2.16),(2.20),(2.21) ถงในสมการที่ (2.17),(2.18),(2.19) จะ เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ 3 สมการในรูปของตัวแปร 3 ตัวแปรคือ  $U_x, U_y, \phi$  เท่านั้น โดยใน โปรแกรม COMSOL จะให้เป็นตัวแปร u,v,V ตามลำคับ

ส่วนชั้นมวลจะจำลองเป็นหน้าตัด 2 มิติโดยใช้โหมคระนาบกวามเก้น (plane stress) ซึ่งมี สมการกวามสัมพันธ์ทางวัสดุกือสมการที่ (2.22) [12]

$$\begin{cases} T_x \\ T_y \\ T_{xy} \end{cases} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} \begin{cases} S_x \\ S_y \\ 2S_{xy} \end{cases}$$
(2.22)

โดยที่

 $E [N/m^2]$  คือค่ายังส์โมดูลัสของชั้นมวล (Young's modulus)

สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไว้ใช้แก้ปัญหาของแข็งใน 2 มิติกือ สมการที่ (2.17),(2.18) และ (2.20) [12] โดยค่า ρ [kg/m³] ในซับโดเมนของมวล กือค่าความหนาแน่นของชั้นมวล

สุดท้ายเมื่อแทนสมการที่ (2.20),(2.22) ลงในสมการที่ (2.17),(2.18) จะได้สมการเชิง อนุพันธ์ 2 สมการของตัวแปร 2 ตัวแปร คือ  $U_x, U_y$  โดยในโปรแกรม COMSOL จะให้เป็นตัวแปร น,v ตามลำดับ

#### 2.3.1 แบบจำลองของ QCM ในโปรแกรม COMSOL

รูปแบบจำลอง QCM ใน 2 มิติแสดงดังรูปที่ 2.4 ตัวควอตซ์แบบ AT-cut เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม กว้าง 8 mm หนา d (ซับโคเมน 1,2,4) และมีระยะอิเล็กโทรดหรือระยะการป้อนแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 2r (ซับโคเมน 2) และมีชั้นมวลเกาะอยู่บนผิวควอตซ์ (ซับโคเมน 3)



รูปที่ 2.4 แบบจำลองของ QCM ใน 2 มิติ

ตัวควอตซ์ (ซับโดเมน 1,2,4) อยู่ในโหมดเพียโซอิเล็กทริกระนาบความเก้น(piezo plane stress)โดยตัวแปรอิสระในโหมดนี้คือ เฟสเซอร์ของการเคลื่อนตัวในแกน x,y และศักย์ไฟฟ้า คือ u,v,V ตามลำคับ ใส่ก่ากงที่วัสดุทางเพียโซอิเล็กทริกของกวอตซ์แบบ AT-cut ตามรูปที่ 2.5 และ 2.6 โดยก่า Elastic-constants c<sub>ij</sub> ของเมตริกซ์ [C<sup>E</sup>] แทนด้วย c<sub>ij</sub> + iωη<sub>q</sub> [9] เมื่อ η<sub>q</sub> คือก่ากวามหนืด ของกวอตซ์แบบ AT-cut มีก่าเท่ากับ 3.05×10<sup>-4</sup> N/m<sup>2</sup>.s โดยใส่เพื่อให้แบบจำลองใกล้สภาพจริงมาก ขึ้น และกวามหนาทางแกน z ของแผ่นกวอตซ์กำหนดให้เป็น 8 mm

domains Groups	Material Constraint	Load / Charge Damping Init E	lement Color
bdomain selection	Material settings		
	Library material:	Load	
	Constitutive form:	Stress-charge form 🖌	
	Material orientation:	xy plane 💙	
	Coordinate system:	Global coordinate system 🗙	
	Quantity	Value/Expression	Description
	CE.	Edit	Elasticity matrix
<u> </u>	e	Edit	Coupling matrix
oup:	Ers Contract	Edit	Relative permittivity
Select by group	ρ	2648	Density
Active in this domain	thickness	8e-3	Thickness

รูปที่ 2.5 การใส่ค่าวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์แบบ AT-cut ในโปรแกรม COMSOL

JOINTEST J. Olliega	pps*38.25e9+j*omec	ja_pps*3.( <mark>27.15e9+j*ome</mark> c	ga_pps*33.66e9+j*ome	ga_pps*3.(j*omega_pps*	3.05e-4 j*omega_pps*3.05e-4
8.25e9+j*omega_p	ops*3.1 129.77e9+j*om	ega_pps*3 <mark>-7.42e9+j*ome</mark> g	a_pps*3.( <mark>5.7e9+j*</mark> omega	_pps*3.05 j*omega_pps*	3.05e-4 j*omega_pps*3.05e-4
7.15e9+j*omega_	pps*37.42e9+j*omeg	ja_pps*3. 102.83e9+j*ome	ega_pps*3 <mark>9.92e9+j*omeg</mark>	a_pps*3.0 j*omega_pps*	3.05e-4 j*omega_pps*3.05e-4
3.66e9+j*omega_p	ops*3.15.7e9+j*omega	_pps*3.05 9.92e9+j*omega	a_pps*3.0 38.61e9+j*ome	ga_pps*3. j*omega_pps*	3.05e-4 j*omega_pps*3.05e-4
*omega_pps*3.05e	e-4 j*omega_pps*3.	05e-4 j*omega_pps*3.	05e-4 j*omega_pps*3	.05e-4 68.81e9+j*om	ega_pps*3. <mark>2.54e9+j*omega_pps*</mark>
fomega_pps#3.05e	e-4 j*omega_pps*3.	05e-4 j*omega_pps*3.	05e-4 j*omega_pps*3	.05e-4 2.54e9+j*ome	ga_pps*3.0 29.01e9+j*omega_pps
upung marrix,	stress-charge for	1		1-2	
oupting matrix,	stress-charge forn	1			
171	1523	0187	.067	0	00
	0	0	0	.1077	0949
	0	0	0	0761	.0671
	Rel	ative permittivity, str	ess-charge form	×	
	Rel 4.4	at <mark>ive permittivity, str</mark> 128 0	ess-charge form 0	×	OK Cance
	Rel	at <mark>ive permittivity, str</mark> 128 0 4.4	ess-charge form 0 97 .09	7	OK Cance

รูปที่ 2.6 เมตริกซ์ค่าคงที่ทางวัสคุเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์แบบ AT-cut โดยตัวแปร omega\_pps คือค่าความถี่เชิงมุม *w* 

ชั้นมวล (ซับโดเมน 3) ในโหมดระนาบกวามเก้น(plane stress) มีตัวแปรอิสระในโหมดนี้ กือ เฟสเซอร์ของการเกลื่อนตัวในแกน x,y คือ u,v ตามลำดับ ใส่ก่ากงที่วัสดุของวัสดุที่เป็นลักษณะ ของแข็งแบบ isotropic ตามรูปที่ 2.7 โดยใส่ก่า Young's modulus E, poisson's ratio V, กวาม หนาแน่น ρโดยให้ก่ากวามหนาทางแกน z ของชั้นมวลเป็น 8 mm

Material Constrain	t Load Damping Initial Stress	and Strain PML Init Element Color
Material settings		
Library material:	Load	]
Material model:	Isotropic material	
Coordinate system	m: Global coordinate system 🔽	
Use mixed U-	P formulation (nearly incompressib	le material)
Quantity	Value/Expression	Description
E	78e9	Young's modulus
v	0.44	Poisson's ratio
1 1 3.45		
0	al and the	Thermal expansion coeff
0 0000	19300	Density
-		D ON DRY
	Material Constrain Material settings Library material: Material model: Coordinate system Use mixed U- Quantity E V	Material Constraint Load Damping Initial Stress         Material settings         Library material: <ul> <li>Load</li> <li>Material model:</li> <li>Isotropic material</li> <li>Coordinate system:</li> <li>Global coordinate system</li> <li>Use mixed U-P formulation (nearly incompressite</li> </ul> Quantity       Value/Expression         E       78e9         v       0.44

รูปที่ 2.7 การใส่ค่าวัสดุที่ชั้นมวล

การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตจะใช้การกำหนดหมายเลขขอบเขตตามรูปที่ 2.8 และกำหนด เงื่อนไขขอบเขตตามรูปที่ 2.9

เงื่อนไขทางกล: ขอบซ้าย(1)และขอบขวา(15) Fixed , ขอบอื่นๆ (2,3,5,6,7,9,10,11,13,14) ปล่อย Free , ขอบที่เชื่อมระหว่างควอตซ์และชั้นมวล (8) เป็นการต่อเนื่องของการเคลื่อนตัว u,v

เงื่อนไขทางไฟฟ้า: ขอบล่าง(5) ground , ขอบบน(6,8,11)  $V_0 = \phi_0$  [Vpeak] , ขอบอื่นๆ (1,2,3,13,14,15) zerocharge/symmetry



รูปที่ 2.9 การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตของ QCM

การกำหนดตัวแปรความถี่ที่ทำการแปรค่า กำหนดให้เป็นตัวแปร freq ซึ่งกำหนดให้เป็นค่า เดียวกันทั้งในโหมดเพียโซอิเล็กทริกระนาบความเก้น (piezo plane stress : freq\_pps) ของแผ่น ควอตซ์แบบ AT-cut และโหมดระนาบความเก้น (plane stress : freq\_ps) ของชั้นมวลดังแสดงในรูป ที่ 2.10

Name	Expression	Description
req_pps	freq	Excitation frequency
epsilon0	8.854187817e	Permittivity of vacuum
req_ps	freq	Excitation frequency
_old_ini_ps	-1	Initial condition previous time step (contact with dynamic fric.
		SALL.

รูปที่ 2.10 การกำหนดตัวแปรความถี่ freq ให้เป็นตัวเดียวกัน

ทั้งในโหมด piezo plane stress(pps) และในโหมด plane stress(ps)

ใช้เอลิเมนต์ทั้งหมดเป็นแบบ lagrange-quadratic แล้วใช้การแก้ปัญหาเป็นแบบ frequency response (parametric solver) คือหาผลตอบสนองเชิงความถี่ในแต่ละตัวแปร freq ที่แปรค่าไป รูปที่ 2.11 เป็นตัวอย่างการใช้ parametric solver โดยแปรค่าตัวแปรความถี่จำนวน 11 ค่า ตั้งแต่ freq = 9938395 ถึง freq = 9938405 โดยแปรค่าห่างกันตัวละ 1 Hz



nalysis:	General Parametric Stationary Adaptive Advanced
Frequency response	Parameter         Name of parameter:       freq         List of parameter values:       9938395:1:9938405         Linear system solver       Linear system solver:         Linear system solver:       Direct (UMFPACK)         Preconditioner:       Settings
Adaptive mesh refinement	Matrix symmetry: Nonsymmetric

รูปที่ 2.11 การแก้ปัญหาผลตอบสนองเชิงความถี่ (frequency response) โดยใช้ parametric solver หาผลตอบในแต่ละความถี่ freq

#### 2.4 การหาความถี่เรโซแนนซ์

หากวามถี่เร โซแนนซ์จากกวามถี่แรกที่ทำให้เกิดก่าขนาดของแอคมิตแตนซ์สูงสุด ซึ่งแอด มิตแตนซ์หาได้จากสมการที่ (2.23)

$$Y(\omega) = \frac{I(\omega)}{V(\omega)}$$

(2.23)

โดยที่

Y(ω) [S] คือแอคมิตแตนซ์

I(w) [Apeak] คือเฟสเซอร์ของกระแสไฟฟ้า

 $V(\omega)$  [Vpeak] คือเฟสเซอร์ของแรงคันไฟฟ้า

 $\omega$  [rad/s] คือความถี่เชิงมุม

ในแบบจำลองใช้ขนาดของแรงคันไฟฟ้ากงที่เป็น  $V(\omega) = \phi_0$  [Vpeak] คังนั้นแอคมิตแตนซ์ มีก่าตามสมการที่ (2.24)

18

$$Y(\omega) = \frac{I(\omega)}{\phi_0}$$

(2.24)

ซึ่งก่าของกระแสไฟฟ้า I(ω) หาได้จากการอินทิเกรตกระแสไฟฟ้าเชิงผิวทั่วทั้งพื้นผิว อิเล็กโทรด ตามสมการที่ (2.25)

$$I(\omega) = \int_{S} -J_{n}(\omega)ds = (\int_{L} -J_{n}(\omega)dl) \cdot width$$
(2.25)

โดยที่

J<sub>n</sub>(ω) [Apeak/m<sup>2</sup>] คือเฟสเซอร์ของกระแสไฟฟ้าเชิงผิวที่ตั้งฉากไปทางค้านนอกกับผิว อิเล็กโทรด

S  $[m^2]$  คือพื้นผิวอิเล็กโทรด

L [m] คือเส้นแนวอิเล็กโทรด

width [m] คือความหนาของควอตซ์ในแนวแกน z (กำหนดให้เป็น 8 mm)

จากทฤษฎีของ Maxwell จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเชิงผิวกับการกระจัดทาง ไฟฟ้าเป็นไปตามสมการที่ (2.26)

$$J = -\frac{\partial D}{\partial t}$$
(2.26)

โดยที่

 $J \left[ A/m^2 
ight]$  คือกระแสไฟฟ้าเชิงผิว

D [C/m²] คือการกระจัดทางไฟฟ้า

เมื่อกิคเป็นผลตอบสนองเชิงความถี่จะ ได้ความสัมพันธ์ตามสมการที่ (2.27)

$$J_n(\omega) = -i\omega D_n(\omega) \tag{2.27}$$

โดยที่

 $D_n(\omega)$  [Cpeak/m²] คือเฟสเซอร์ของการกระจัดทางไฟฟ้าที่ตั้งฉากไปทางด้านนอกกับผิว อิเล็กโทรด

#### 2.4.1 การหาความถี่เรโซแนนซในโปรแกรม COMSOL

ทำการอินทิเกรตกระแสไฟฟ้าเชิงผิวที่ตั้งฉากกับอิเล็กโทรคด้านบนในทิสพุ่งเข้า – J<sub>n</sub>( $\omega$ ) ตามสมการ (2.25) ที่บริเวณผิวอิเล็กโทรคด้านบน ซึ่งตัวแปร J<sub>n</sub>( $\omega$ ) ในโปรแกรม COMSOL คือ nJ\_pps ดังแสดงในรูปที่ 2.12 การอินทิเกรตจะเป็นผลรวมกระแสไฟฟ้าเชิงผิวตามเส้นขอบที่ กำหนดให้เป็นอิเล็กโทรด (ขอบ 6,8,11) แต่เนื่องจากในแบบจำลองกำหนดให้ความหนาของแผ่น ควอตซ์เป็น 8 mm ดังนั้นการอินทิเกรตตามเส้นขอบนี้เมื่อคูณด้วยค่า *width*= 0.008 m จึง กลายเป็นการอินทิเกรตเชิงพื้นที่

idary Integrat	ion Va	riables				Þ
Irce Destination						
oundary selection		Name	Expression	Integration order	Global destination	
	^	I	-nJ_pps*0.008	4		~
					Image: A start of the start	
					Image: A start of the start	
					Image: A start of the start	
					Image: A start of the start	
0					Image: A start of the start	
1					Image: A start of the start	
2	~				Image: A start of the start	
3					Image: A start of the start	
Select by group	2				V	~

รูปที่ 2.12 การอินทิเกรตกระแสไฟฟ้าเชิงผิวที่บริเวณอิเล็กโทรดบนทั้งหมด

เมื่ออินทิเกรตแล้วค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละความถี่  $I(\omega)$  จะเก็บไว้ในตัวแปร I ใน โปรแกรม COMSOL ซึ่งจะถือว่า abs(I) คือ ขนาดของกระแสไฟฟ้าหรือขนาดของแอดมิตแตนซ์ ดูณด้วย  $\phi_0$ นั่นเอง  $(|I(\omega)| = \phi_0 |Y(\omega)|)$  ในแบบจำลองที่ไม่ได้ทำการแปรค่าศักย์ไฟฟ้าจะให้ก่า  $\phi_0 = 1$  Vpeak

จากนั้นจะทำการหาความถี่เรโซแนนซ์โดยการแปรค่า freq ในโปรแกรม COMSOL ที่ทำ ให้ได้ค่าแอดมิตแตนซ์สูงสุดหรือ abs(I) สูงสุดนั่นเอง โดยใช้ความละเอียดในการแปรค่าตัวแปร freq ถึง 1 Hz ดังแสดงในรูปที่ 2.13 และ 2.14





พร้อมทั้งการหาความถี่ freq ที่ทำให้เกิดค่า abs(I) สูงสุด

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🗗 admittance - Notepad		
File Edit Format View	Help	
9938463.0 9938464.0 9938465.0 9938465.0 9938465.0 9938467.0 9938469.0 9938470.0 9938470.0 9938471.0 9938472.0 9938472.0 9938472.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 9938475.0 905875.0 905875.0 905875.0 905875.0 905875.0 905875.0 90587	1.259002 1.3548582 1.465878 1.5957584 1.7494009 1.933373 2.1565256 2.4307215 2.7713435 3.1962795 3.719156 4.325835 4.9197073 5.2757263 max 5.179447 4.6951923 4.076137 3.4974372 3.0142965 2.6251304 2.3130696	
9938484.0 9938485.0 9938486.0 9938487.0	2.0608816 1.8545992 1.683647 1.5401686	
5		2

รูปที่ 2.14 การหาก่า<mark>กวามถี่ freq (9938476.0) ที่ทำให้เกิ</mark>ดก่า abs(I) สูงสุด (5.2757263)

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# บทที่ 3

#### กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

หลังจากที่ได้มีการศึกษาทฤษฎีและสมการเบื้องต้นทางเพียโซอิเล็กทริกที่เกี่ยวเนื่องกับการ สั่นของควอตซ์ไปแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของโปรแกรม COMSOL และ แบบจำลองที่สร้างขึ้น จึงทำการวิเคราะห์ปัญหาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีการวิจัยมาในอดีต ใน หัวข้อต่างๆต่อไปนี้

- 1. ทคสอบโปรแกรม COMSOL กับปัญหาเพียโซอิเล็กทริกทั่วไปที่มีผลเฉลยแม่นตรง
- การวิเคราะห์ความถี่เร โซแนนซ์ของแผ่นควอตซ์ AT-cut เมื่อเปลี่ยนความหนาด้วย โปรแกรม COMSOL เทียบกับผลเฉลยแม่นตรงของความถี่เร โซแนนซ์เมื่อเปลี่ยน ความหนาใน 1 มิติ
- การวิเคราะห์โหมดการสั่นของควอตซ์แบบ AT-cut ในโปรแกรม COMSOLว่าเป็น แบบ thickness shear mode
- 4. การวิเคราะห์การสั่นของควอดซ์แบบ AT-cut ที่ความถี่ฮาร์โมนิกลี่ในโปรแกรม COMSOL ว่าเป็นการสั่นแบบครึ่งคลื่น
- การจำลองควอตซ์แบบ AT-cut ในการทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัคมวลที่มีลักษณะ ยูนิฟอร์ม หรือเรียกว่า QCM ที่ใช้ตรวจวัคมวลแบบยูนิฟอร์ม ว่ามีลักษณะตรงตาม สมการของ Sauerbrey หรือไม่

การคำนวณใช้คอมพิวเตอร์ CPU 1.5 GHz หน่วยความจำ 2 GB

#### 3.1 ทรงกระบอกเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกที่ถูกกระทำโดยโหลดคงที่

ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์โครงสร้างทรงกระบอกเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกสมมาตรรอบแกน z ดังรูปที่ 3.1 ที่ถูกป้อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับขนาด  $\phi_0 = 1$  Vpeak ที่ความถี่ 1 MHz ในแนวแกน z และถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขขอบเขตที่ผิวของทรงกระบอก คือ มีการเคลื่อนตัวขนาด  $\pm U_0 = \pm 0.1$ nmpeak ที่ผิวบนและผิวล่างของทรงกระบอกในทิศแกน z และ มีการเคลื่อนตัวขนาด  $W_0 = 0.1$ nmpeak ที่ผิวข้างของทรงกระบอกในแนวรัศมี r โดยรัศมีของทรงกระบอก a = 5 mm และความ สูงของทรงกระบอก L = 10 mm จากนั้นจะนำผลที่กำนวณได้จากโปรแกรม COMSOL มา เปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงของ D. D. Ebenzer และ R. Ramesh [13]



รูปที่ 3.1 โมเคลของทรงกระบอกเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก

## 3.1.1 ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก

ค่าทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกนี้มีค่าดังตารางที่ 3.1 ซึ่งมีความสมมาตรรอบแกน z หรือสามารถเขียนเป็นเมตริกซ์ได้ตามรูปที่ 3.2

Density	ρ	7500	kg/m <sup>3</sup>
Relative permittivity	$\varepsilon_{11}^{s} / \varepsilon_{0} = \varepsilon_{22}^{s} / \varepsilon_{0}$	730	
6	$\varepsilon_{33}^{s}/\varepsilon_{0}$	635	
elasticity	$c_{11}^E = c_{22}^E$	13.9×10 <sup>10</sup>	N/m <sup>2</sup>
	$c_{12}^{E} = c_{21}^{E}$	$7.78 \times 10^{10}$	N/m <sup>2</sup>
ล์ ถ`	$c_{13}^E = c_{23}^E = c_{31}^E = c_{32}^E$	7.43×10 <sup>10</sup>	N/m <sup>2</sup>
	<i>c</i> <sup><i>E</i></sup> <sub>33</sub>	11.5×10 <sup>10</sup>	N/m <sup>2</sup>
<b>NN 161</b>	$c_{44}^{E} = c_{55}^{E}$	2.56×10 <sup>10</sup>	N/m <sup>2</sup>
4	$c_{66}^{E} = \frac{1}{2}(c_{11}^{E} - c_{12}^{E})$	3.06×10 <sup>10</sup>	N/m <sup>2</sup>
Coupling coefficient	<i>e</i> <sub>31</sub>	-5.2	C/m <sup>2</sup>
	e <sub>33</sub>	15.1	C/m <sup>2</sup>
	<i>e</i> <sub>15</sub>	12.7	C/m <sup>2</sup>
ค่าอื่นๆนอกจากที่กล่าวม	าข้างต้น	0	

# ตารางที่ 3.1 <mark>ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกขอ</mark>งเซรามิกทรงกระบอก

lasticity matr	іх				
13.9e10	7.78e10	7.43e10	0	0	0
7.78e10	13.9e10	7.43e10	0	0	0
7.43e10	7.43e10	11.5e10	0	0	0
)	0	0	2.56e10	0	0
)	0	0	0	2.56e10	0
5	0	0	0	0	3.06e10
oupling matr	ix, stress-charge form				
0	0	0	0	127	0
0	0	0	0	12.7	0
0 0 -5.2	0 0 -5.2	0 0 15.1	0 12.7 0	12.7 0 0	0 0 0 0
0 0 -5.2	0 0 -5.2	0 0 15.1	0 12.7 0	12.7 0 0	0 0 0 OK Cancel
0 0 -5.2	0 0 -5.2 Rela	0 0 15.1 stive permittivity, stra	0 12.7 0 ess-charge form	12.7 0 0	0 0 0 OK Cancel
0 0 -5.2	0 0 -5.2 Rela 730	0 0 15.1 ative permittivity, stro	0 12.7 0 ess-charge form 0	12.7 0 0	0 0 0 OK Cancel
0 0 -5.2	0 0 -5.2 Rela 730	0 0 15.1 stive permittivity, stra 0 0 730	0 12.7 0 ess-charge form 0 0	12.7 0 0	0 0 0 OK Cancel

รูปที่ 3.2 เมตริกซ์ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก

#### 3.1.2 ผลเฉลยแม่นตรงของ D. D. Ebenezer และ R. Ramesh[13]

ผลเฉลยแม่นตรงที่จะนำมาเปรียบเทียบในที่นี้คือ การเคลื่อนตัวในแนวแกน z(U), การ เคลื่อนตัวในแนวรัศมี r(W), ศักย์ไฟฟ้า ( $\phi$ ), การกระจัดทางไฟฟ้าในแนวแกน  $z(D_z)$  ซึ่งแสดง ไว้ดังสมการที่ (3.1) ถึง (3.4) โดยละเทอมของเวลาทิ้งไป (กิดเฉพาะเฟสเซอร์โดยตัด  $\cos(\omega t)$ ออก)

$$U = A\sin(K_z z) \tag{3.1}$$

$$W = BJ_1(K_r r) \tag{3.2}$$

$$\phi = A \frac{e_{33}}{\varepsilon_{33}^{s}} \sin(K_z z) + Dz + E$$
(3.3)

OK Cancel

$$D_{z} = Be_{31}K_{r}J_{0}(K_{r}r) - D\varepsilon_{33}^{s}$$
(3.4)

เมื่อ

$$K_{z} = \omega \sqrt{\frac{\rho}{c_{33}^{E} + e_{33}^{2} / \varepsilon_{33}^{S}}} = 2\pi 10^{6} \sqrt{\frac{7500}{11.5 \times 10^{10} + 15.1^{2} / 5622.4 \times 10^{-12}}} = 1379.7$$
$$K_{r} = \omega \sqrt{\frac{\rho}{c_{11}^{E}}} = 2\pi 10^{6} \sqrt{\frac{7500}{13.9 \times 10^{10}}} = 1459.5$$
$$A = \frac{U_{0}}{\sin(K_{z}L/2)} = 1.733 \times 10^{-10}$$

$$B = \frac{W_0}{J_1(K_r a)} = 1.2214 \times 10^{-9}$$
$$D = \frac{\phi_0}{L} - \frac{2e_{33}}{L\varepsilon_{33}^s} U_0 = 46.2864$$
$$E = \frac{\phi_0}{2} = 0.5$$

#### 3.1.3 แบบจำลองในโปรแกรม COMSOL

ใช้โหมดในการจำลองแบบเพียโซอิเล็กทริกสมมาตรรอบแกนกลาง (Piezo Axial Symmetry) คือตัดทรงกระบอกซึ่งเป็นรูปทรง 3 มิติที่สมมาตรรอบแกน z เหลือเป็นหน้าตัดระนาบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 มิติที่กว้างเท่ากับรัศมี a = 5 mm และสูงเท่ากับทรงกระบอก L = 10 mm ดังรูปที่ 3.3 ใช้การคำนวณแบบผลตอบสนองเชิงความถี่ frequency response (parmetric solver) ที่ความถี่ 1 MHz ซึ่งมีเงื่อนไขขอบเขตดังต่อไปนี้

เงื่อนไขทางกล: ขอบซ้าย(1) plane symmetry , ขอบล่าง(2) Rz =  $-U_0$  = -0.1 nm , ขอบบน (3) Rz =  $U_0$  = 0.1 nm , ขอบขวา(4) Rr =  $W_0$  = 0.1 nm

เงื่อนไขทางไฟฟ้า: ขอบซ้าย(1) axial symmetry , ขอบล่าง(2) ground , ขอบบน(3) Vo $=\phi_0=1$  , ขอบขวา(4) zerocharge/symmetry



รูปที่ 3.3 ทรงกระบอกที่ถูกจำลองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในโปรแกรม COMSOL

ใช้เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic แบ่งเอลิเมนต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(map mesh) แนวนอน×แนวตั้ง = 50×100 = 5000 เอลิเมนต์ รูปที่ 3.2 แสดงเมตริกซ์ค่าคงที่ทางวัสดุเพียโซอิ เล็กทริกของเซรามิกทรงกระบอก ที่ใส่ไว้ในสับโดเมน

# 3.1.4 ผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรม COMSOL

รูปที่ 3.4 ถึง 3.7 แสดงผลการคำนวณ ค่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน z , ค่าการเคลื่อนตัวใน แนวรัศมี r , ค่าศักย์ไฟฟ้า และค่าการกระจัดทางไฟฟ้าในแนวแกน z ตามลำดับ โดยใช้โปรแกรม COMSOL เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากสมการของ Ebenezer-Ramesh



รูปที่ 3.4 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการเคลื่อนตัวในแนวแกน z



รูปที่ 3.5 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการเกลื่อนตัวในแนวรัศมี r



รูปที่ 3.6 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของศักย์ไฟฟ้า



รูปที่ 3.7 ผลเฉลยแม่นตรงเทียบกับโปรแกรม COMSOL ของการกระจัดทางไฟฟ้าในแนวแกน z

จากรูปที่ 3.4 ถึง 3.7 พบว่าโปรแกรม COMSOL มีความแม่นยำในการคำนวณค่าทางเพีย โซอิเล็กทริกใกล้เคียงกับการวิเคราะห์

#### 3.2 ผลของความหนาที่มีต่อความถี่เรโซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cut

ในหัวข้อนี้ได้ทำการหาผลเฉลยแม่นตรงของความที่เรโซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cut ซึ่งเป็นการคำนวณใน 1 มิติโดยขึ้นกับความหนาของควอตซ์ (*d*) และคุณสมบัติทางวัสดุของ ควอตซ์ เปรียบเทียบกับผลการคำนวณความถี่เรโซแนนซ์ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL ซึ่งเป็นการ คำนวณ ใน 2 มิติ

#### 3.2.1 ผลเฉลยแม่นตรงของความถี่เรโซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cut ใน 1 มิติ

เมื่อพิจารณาค่าทางวัสดุของแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut จะพบว่าการเคลื่อนตัวที่เกิดจากการ ป้อนไฟฟ้ากระแสสลับในแนวความหนาของควอตซ์ (แกน y) จะเป็นลักษณะคลื่นเฉือน (shear wave) ที่เคลื่อนที่ไปในแนวแกน y แต่อนุภาคจะมีการสั่นในแนวตั้งฉากกัน (แกน x) ดังรูปที่ 3.8 และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขขอบเขตที่ปล่อยให้ผิวของควอตซ์ทั้งบนและล่างเป็นอิสระด้วยแล้ว ที่ ความถี่เร โซแนนซ์ การเคลื่อนตัวของคลื่นจะมีค่าสูงสุดที่ผิวบนและผิวล่างของควอตซ์ ทำให้คลื่น เกลื่อนที่ผ่านตัวกลางควอตซ์เป็นระยะครึ่งลูกคลื่นเท่านั้น ( $\frac{n\lambda}{2}, n = 1,3,5,...$ ) ดังนั้นที่ความถี่เร โซแนนซ์แรกของคลื่นเฉือนนี้จึงเคลื่อนที่ผ่านควอตซ์เป็นระยะครึ่งลูกคลื่น ( $\frac{\lambda}{2}$ )



รูปที่ 3.8 การเคลื่อนที่แบบเฉือนในแนวความหนา (thickness shear mode) ของควอตซ์ AT-cut

ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าการสั่นของควอตซ์จะขึ้นกับค่าคงที่ทางเพียโซอิเล็กทริกของควอตซ์แบบ AT-cut และทิศทางการป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ จึงสามารถประมาณสมการทางเพียโซอิเล็กทริก เหลือเพียง 1 มิติในแนวความหนา (แกน y) และเหลือเพียงความเค้น (stress) ความเครียด(strain)ใน แนวเฉือน (shear) บนระนาบ xy ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวในแนว x (*u<sub>x</sub>*) ที่ระยะในแนวแกน y ต่างๆเท่านั้น สมการเพียโซอิเล็กทริกที่เหลือใน 1 มิติจึงสามารถลดรูปจากสมการที่ (2.15)ได้เป็น สมการที่ (3.5) และ (3.6)

$$T_{xy} = c_{66}^{E} (2S_{xy}) - e_{26}E_{y}$$
(3.5)

$$D_{y} = e_{26}(2S_{xy}) + \varepsilon_{22}^{S}E_{y}$$
(3.6)

โดยที่

 $T_{xy}$  [N/m<sup>2</sup>] คือความเค้นเฉือน (shear stress) ในระนาบ xy

 $S_{xy}$  [-] คือความเครียดเฉือน (shear strain) ในระนาบ xy

 $D_{y}$  [C/m<sup>2</sup>] คือการกระจัดทางไฟฟ้า (electric displacement) ในแนว y

 $E_{y}$  [V/m] คือสนามไฟฟ้า (electric field) ในแนว y

 $c_{66}^{E} = 29.01 \times 10^{9} \text{ N/m}^{2}$ 

 $e_{26} = -0.0949 \text{ C/m}^2$ 

$$\mathcal{E}_{22}^{S} = 39.817 \times 10^{-12} \, \mathrm{F/m}$$

เมื่อพิจารณาสมการเชิงอนุรักษ์โมเมนตัม (newton's law) ในแนวแกน x สมการที่(2.7) ถึง (2.9) จะลครูปเป็นสมการที่ (3.7)

$$\frac{\partial T_{xy}}{\partial y} = \rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2}$$
(3.7)

โดยที่

 $u_x$  คือการเคลื่อนตัว (displacement) ในแนวแกน x

ho คือความหนาแน่นของควอตซ์ (density) มีค่า 2648 kg/m  $^3$ 

เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาสมการเชิงอนุรักษ์ประจุ (guass's law) ขณะที่ไม่มีประจุอยู่ภายใน ควอตซ์ สมการที่ (2.11) จะลดรูปเป็นสมการที่ (3.8)

31

$$\frac{\partial D_{y}}{\partial y} = 0 \tag{3.8}$$

เมื่อนำสมการที่ (3.5) แทนลงในสมการที่ (3.7) จะได้สมการที่ (3.9)

$$c_{66}^{E} \frac{\partial (2S_{xy})}{\partial y} - e_{26} \frac{\partial E_{y}}{\partial y} = \rho \frac{\partial^{2} u_{x}}{\partial t^{2}}$$
(3.9)

เมื่อนำสมการที่ (3.6) แทนลงในสมการที่ (3.8) จะได้สมการที่ (3.10)

$$e_{26}\frac{\partial(2S_{xy})}{\partial y} + \varepsilon_{22}^{s}\frac{\partial E_{y}}{\partial y} = 0$$
(3.10)

เมื่อรวมสมการที่ (3.9) และ (3.10) เข้าด้วยกันโดยใช้เทอม  $\frac{\partial E_y}{\partial y}$  เป็นตัวร่วมจะได้สมการ

ที่ (3.11)

$$\left(c_{66}^{E} + \frac{e_{26}^{2}}{\varepsilon_{22}^{S}}\right)\frac{\partial(2S_{xy})}{\partial y} = \rho \frac{\partial^{2}u_{x}}{\partial t^{2}}$$
(3.11)

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดเฉือนในระนาบ xy (S<sub>xy</sub>) กับการเคลื่อนตัวใน แนว x  $(u_x)$  เมื่อละทิ้งการเคลื่อนตัวในแนว y  $(u_y)$  สมการที่ (2.20) จะลดรูปเป็นสมการที่ (3.12)

$$S_{xy} = \frac{1}{2} \frac{\partial u_x}{\partial y}$$
(3.12)

แทนสมการที่ (3.12) ลงในสมการที่ (3.11) จะได้สมการคลื่น (wave equation) ดังสมการที่ (3.13)

$$\left(c_{66}^{E} + \frac{e_{26}^{2}}{\varepsilon_{22}^{s}}\right)\frac{\partial^{2}u_{x}}{\partial y^{2}} = \rho \frac{\partial^{2}u_{x}}{\partial t^{2}}$$
(3.13)

เนื่องจากสามารถพิจารณาในรูปผลตอบสนองเชิงความถี่ได้ดังนั้นสมการที่ (3.13) สามารถ เขียนได้เป็นสมการที่ (3.14) [14]

$$c_{66}^{E} + \frac{e_{26}^{2}}{\varepsilon_{22}^{S}} \frac{d^{2}U_{x}}{dy^{2}}(y) = -\rho\omega^{2}U_{x}(y)$$
(3.14)

โดยที่

 $\omega$  [rad/s] คือความถี่เชิงมุม

 $U_x(y)$  [m] คือเฟสเซอร์ของการเคลื่อนตัวในแนวแกน x ,  $u_x(y,t)$ ซึ่งผลเฉลยของสมการที่ (3.14) นี้จะอยู่ในรูปแบบสมการที่ (3.15)

$$U_{x}(y) = A\cos(ky) + B\sin(ky)$$
(3.15)

โดยที่

$$k = \omega \sqrt{\frac{\rho}{c_{66}^E + e_{26}^2 / \varepsilon_{22}^S}}$$
เป็นเลขคลื่น (wave number)  
A, B เป็นค่าคงที่

จากสมการที่ (3.16)

$$k = \frac{\omega}{v}$$
 โดย  $v$  (m/s) คือความเร็ว (velocity) คลื่น (3.16)

จะได้ว่ากวามเร็วของกลื่นในตัวกลางกวอตซ์แบบ AT-cut คือสมการที่ (3.17)

$$v = \sqrt{\frac{c_{66}^{E} + e_{26}^{2} / \varepsilon_{22}^{S}}{\rho}}$$
(3.17)

ความถี่เร โซแนนซ์  $f_s$  [Hz] จึงหาได้จากสมการที่ (3.18)

$$f_s = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2d} \sqrt{\frac{c_{66}^E + e_{26}^2 / \varepsilon_{22}^s}{\rho}} = \frac{1661.3890855}{d}$$
(3.18)

โดยที่

d [m] เป็นความหนาของควอตซ์แบบ AT-cut

ส่วนผลเฉลยแม่นตรงของการเคลื่อนตัวในแนวแกน x  $(u_x)$  และค่าศักย์ไฟฟ้า  $(\phi)$  หาได้ จากความสัมพันธ์  $E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$  และเงื่อนไขขอบเขต  $T_{xy}\Big|_{y=0} = T_{xy}\Big|_{y=d} = 0$  ซึ่งแสดงความเป็น อิสระทั้งผิวบนและผิวล่างของควอตซ์  $\phi\Big|_{y=d} = \phi_0 \cos(\omega t), \phi\Big|_{y=0} = 0$  ซึ่งแสดงถึงการป้อนไฟฟ้า กระแสสลับระหว่างผิวบนและผิวล่างของควอตซ์ จะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้

#### 3.2.2 แบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ใน COMSOL แบบ 2 มิติ

ใช้โหมดในการจำลองแบบเพียโซอิเล็กทริก ระนาบความเค้น (piezo plane stress) ดังที่ กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.3.1 จำลองตัวควอดซ์ที่เป็นแผ่นวงกลมรัศมี 4 mm และมีรัศมีอิเล็กโทรด 2.5 mm ใน 3 มิติ ให้เหลือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 mm หนา d และมีขนาดอิเล็กโทรดกว้าง 5 mm ใน 2 มิติ ดังรูปที่ 3.9 แล้วจะทำการแปรค่าความหนา (d) 4 ค่าคือ 83.4,139,166.8 และ 333.6 μm เพื่อดูความถี่เรโซแนนซ์ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL แล้วนำไปเปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรง ของความถี่เรโซแนนซ์ของแบบจำลอง 1 มิติ ในสมการที่ (3.18)





รูปที่ 3.10 เงื่อนใขขอบเขตของควอตซ์แบบ AT-cut

ส่วนที่ซับโดเมนได้ใช้ค่าคงที่ของวัสดุควอตซ์แบบ AT-cut ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยใช้ เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic แบ่งเอลิเมนต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(map mesh) แนวนอน× แนวตั้ง = 240×20 = 4800 เอลิเมนต์ ซึ่งได้มีการทดสอบจำนวนเอลิเมนต์ที่พอเหมาะในการลู่เข้าสู่ กำตอบดังตารางที่ 3.2, 3.3 โดยกำนวณแบบผลตอบสนองเชิงความถี่(frequency respond) เรียกว่า parametric solver โดยมีความถี่ freq เป็นตัวแปรค่า

					1	•	
แนวตั้ง แนวนอน	8	12	16	20	24	28	32
240	11.48	14.44	15.09	15.28	15.35	15.38	15.40
288	11.53 🚽	14.51	15.18	15.37	15.44	N.A.	N.A.
336	11.55 🥖	14.54	15.21	15.40	15.43	N.A.	N.A.
384	11.56	14.56	15.22	15.42	N.A.	N.A.	N.A.
432	11.56	14.56	15.23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
480	11.56	14.56	15.23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
528	11.56	1 <mark>4.5</mark> 6	15.23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ตารางที่ 3.2 ค่า total-displacement [nm] ที่จุดกึ่งกลางที่ผิวควอตซ์ เมื่อ d = 166.8 µm ที่ความถี่ freq = 9938000 Hz เมื่อใช้เอลิเมนต์แบบ map mesh ต่างๆ กัน

หมายเหตุ: N.A. คือ Not Available ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ

ตารางที่ 3.3 ค่า total-displacement [nm] ที่จุดกึ่งกลางที่ผิวควอตซ์ เมื่อ d = 166.8 µm ที่ความถี่ freq = 9938000 Hz เมื่อใช้เอลิเมนต์แบบสามเหลี่ยมต่างๆ กัน

จำนวนเอลิเม <mark>น</mark> ต์สามเหลี่ยม	ค่า total-displacement (nm)
148	0.02
592	0.27
2368	3.11
9472	12.28
13312	15.13
25106	15.08

จากตารางที่ 3.2 , 3.3 จะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดเอลิเมนต์แบบสามเหลี่ยมก็มีค่าลู่เข้าสู่ค่า เดียวกันกับเอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยม แต่เอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยมจะมีความเป็นระเบียบมากกว่าเอลิ เมนต์แบบสามเหลี่ยม จึงเลือกใช้เอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยม และค่าที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ใช้ หน่วยความจำมากเกินไป ค่าที่เลือกมาคือ แนวนอน×แนวตั้ง = 240×20 = 4800 เอลิเมนต์ ซึ่งจะเห็น ว่ามีค่าต่างจากทางขวาของตารางเพียง ( $\left|\frac{15.40-15.28}{15.40}\right| \times 100 = 0.78\%$ ) และมีค่าต่างจากข้างล่าง ของตารางเพียง ( $\left|\frac{15.42-15.28}{15.42}\right| \times 100 = 0.91\%$ ) ที่ความถี่ freq อื่นๆ ก็มีค่าใกล้เคียงเหมือนกับ ค่าการเคลื่อนตัวนี้ และค่าตัวแปรอื่นๆที่ไม่ใช่ total-displacement ก็มีค่าใกล้เคียงเช่นกัน นอกจากนี้จากตารางที่ 3.2 และ 3.3 จะเป็นได้ว่าการใช้เอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยมจะใช้จำนวน เอลิเมนต์ที่น้อยกว่าแบบสามเหลี่ยม

ความถี่เรโซแนนซ์ที่คำนวณได้จากโปรแกรม COMSOL ใน 2 มิติเปรียบเทียบกับผลเฉลย แม่นตรงของความถี่เรโซแนนซ์ใน 1 มิติเป็นดังตารางที่ 3.4

ความหนาของควอตซ์	ความถี่เร โซแนนซ์	ความถี่เร โซแนนซ์	ความคลาดเคลื่อนจาก
d [µm]	[Hz] จากโปรแกรม	[Hz] จากสมการที่	โมเคล 1 มิติ
	COMSOL ใน 2 มิติ	(3.18) ใน 1 มิติ	$\frac{f2-f1}{f1} \times 100\%$
83.4	19864268	19920732	-0.283%
139	11923258	11952439	-0.244%
166.8	9938476	9960366	-0.220%
333.6	4979190	4980183	-0.020%

ตารางที่ 3.4 ความถี่เร โซแนนซ์ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL ใน 2 มิติ เปรียบเทียบกับ ความถี่เร โซแนนซ์ที่ได้จากสมการที่ (3.18) ใน 1 มิติ ที่ความหนาของควอตซ์ d ต่างๆ

แม้ว่าความคลาดเคลื่อนเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากโมเคล 1 มิติจะมีเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อ พิจารณาโดยละเอียดแล้วก็ต่างกันถึงหลักหมื่น Hz เลยทีเดียว ซึ่งความแตกต่างขนาดนี้ถือว่าสูงมาก ในวงจรวัด ความแตกต่างระหว่างโมเดล 2 มิติและ 1 มิติที่เป็นสาเหตุของความแตกต่างนี้กาคว่า เนื่องมาจากการกำหนดให้โมเคล 2 มิติมีคลื่นเคลื่อนที่ทั้งในแกน x และแกน y และควอตซ์มีขนาด รูปร่างที่จำกัดเพียง 8 mm อีกทั้งการป้อนศักย์ไฟฟ้าเพียงบริเวณอิเล็กโทรดซึ่งในที่นี้เป็นระยะ 5 mm และที่ขอบทั้ง 2 ข้างยังมีการยึดไว้อีก ในขณะที่โมเคล 1 มิติคลื่นจะเคลื่อนที่ไปในแกน y เพียงทิศ เดียวและขนาดของควอตซ์ในแกน x จะไม่จำกัด อีกทั้งการป้อนศักย์ไฟฟ้าจะกระจายทั่วทั้งผิว อิเล็กโทรด

#### 3.3 การสันแบบเฉือนในแนวความหนา (Thickness Shear Mode)ของควอตซ์แบบAT-cut

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 3.2.1 ว่าจากก่ากงที่ทางวัสดุของควอตซ์แบบ AT-cut และ ลักษณะการป้อนศักย์ไฟฟ้า จะทำให้การเคลื่อนที่ของควอตซ์เป็นไปในลักษณะเฉือนเป็นส่วนใหญ่ คือการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะมีมากในแนวแกน x และเป็นลักษณะของคลื่นที่แพร่ไปในแนวแกน y หรือเรียกลักษณะการสั่นแบบนี้ว่า Thickness Shear Mode (TSM) [2,15]

#### 3.3.1 การสั่นทั่วบริเวณแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut

ได้ใช้แบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ใน 2 มิติ ตามหัวข้อที่ 3.2.2 เพื่อหาการเคลื่อนตัว ทั่วทั้งแผ่นของควอตซ์ ทั้งการเคลื่อนตัวในแนวแกน x และการเคลื่อนตัวในแนวแกน y ขณะสั่นที่ ความถี่เร โซแนนซ์ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3.11 และ 3.12 ตามลำดับ เมื่อใช้ควอตซ์ที่หนา d = 166.8 µm ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน y มีเพียง 8.48 nm ส่วนการเคลื่อนตัวในแนวแกน x มีก่าสูงถึง 212.3 nm ซึ่งรูปที่ 3.13 แสดงภาพการเคลื่อนตัวรวม ก่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวในแนว y กิดเป็น 4% ของก่าสูงสุดของการเคลื่อนตัวในแนว x ส่วนที่ความหนา d ก่าอื่นอื่นๆ การเคลื่อนตัว



รูปที่ 3.11 การเคลื่อนตัวในแนวแกน x ของแผ่นควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อมีความหนา d=166.8 µm ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz



# 3.3.2 การสั่นที่ผิวบนของควอตซ์แบบ AT-cut

รูปที่ 3.14 แสดงการเคลื่อนตัวที่ผิวบนของควอตซ์ในแนวแกน x และแกน y ขณะสั่นที่ ความถี่เรโซแนนซ์ เมื่อใช้ควอตซ์ที่หนา d = 166.8 µm จากรูปจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวใน แนวแกน x ที่ผิวเป็นลักษณะเกาส์เซียน (guassian) คือมีการเคลื่อนตัวสูงสุดที่บริเวณกลาง อิเล็กโทรดและมีการเคลื่อนตัวลดน้อยลงที่บริเวณห่างจากกึ่งกลางอิเล็กโทรดซึ่งเป็นไปในทำนอง เดียวกับการรายงานของKuntner และ Jakoby[16] จากรูปจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน x นั้นสูงกว่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน y



รูปที่ 3.14 การเคลื่อนตัวในแนวแกน x และแกน y ที่ผิวบนของควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อความหนาของควอตซ์ d = 166.8 µm ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz

#### 3.3.3 การสั่นที่บริเวณกึ่งกลางของควอตซ์แบบ AT-cut (ตำแหน่ง x = 0)

เมื่อพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนตัวในแนวแกน x และแกน y ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของควอตซ์ (หรือที่ตำแหน่ง x = 0) ซึ่งเป็นคลื่นที่แพร่ไปในแนวแกน y ขณะสั่นที่ความถี่เรโซแนนซ์ แสดงใน รูปที่ 3.15 เมื่อใช้ควอตซ์หนา d = 166.8  $\mu$ m ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน y มีเพียง เล็กน้อย (มีค่าสูงสุด 1.44×10<sup>-21</sup> m) ส่วนการเคลื่อนตัวในแนวแกน x มีมาก คือมีค่าสูงสุด 205.02 nm ส่วนที่ความหนา d ค่าอื่นๆ การเคลื่อนตัวในแนวแกน x มีมากกว่าการเคลื่อนตัวในแนวแกน y เช่นเดียวกัน ผลที่ได้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของ Martin และคณะ [17] และเป็นลักษณะของ คลื่นเฉือนที่เคลื่อนที่ในแนวแกน x และแพร่ไปในแกน y



รูปที่ 3.15 การเคลื่อนตัวในแนวแกน x และแกน y ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อความหนาของควอตซ์ d = 166.8 µm ที่ความถี่เร โซแนนซ์ 9938476 Hz

# 3.4 ลักษณะของคลื่นเฉือนที่เกิดขึ้นที่ควอตซ์แบบ AT-cut ที่ความถี่เรโซแนนซ์

ที่ความถี่เรโซแนนซ์แรก ความถี่เรโซแนนซ์ที่สอง และสาม จะเกิดคลื่นเฉือนเคลื่อนที่ใน แนวความหนาควอตซ์แบบ AT-cut เป็นระยะ  $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$  ตามลำคับ โดยมีการเคลื่อนตัวสูงสุดที่ ผิว ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.2.1 ค่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ 1,2,3 แสดงดังตารางที่ 3.5 และกราฟของ แอดมิตแตนซ์แสดงดังรูปที่ 3.16 จะเห็นว่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ 2 และ 3 มีค่าเป็น 3 และ 5 เท่าของ ความถี่เรโซแนนซ์ที่ 1 ตามลำดับ ตารางที่ 3.5 ค่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ 1,2,3 พร้อมทั้งแอคมิตแตนซ์ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL

		-	
เร โซแนนซ์ที่	ฮาร์ โมนิกที่	ความถี่เร โซแนนซ์(Hz)	แอคมิตแตนซ์สูงสุค (S)
1	1	4979190	2.45
2	3	14939432	0.30
3	5	24906753	0.11

ใช้ควอตซ์หนา d = 333.6 µm



คลื่นเฉือนที่ปรากฏที่ความถี่เรโซแนนซ์ที่ 1,2,3 (ฮาร์โมนิกที่ 1,3,5) จะเคลื่อนที่ผ่าน ควอตซ์ในแนวความหนา (แกน y) เป็นระยะ  $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$  ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานของ Martin และคณะ [17] สามารถแสดงได้โดยโปรแกรม COMSOL โดยใช้แบบจำลองของควอตซ์ซึ่งหนา d=333.6 µm แล้วดูค่าของการเคลื่อนตัวในแนวแกน x ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง(แกน x = 0)ของควอตซ์ แบบ AT-cut ดังแสดงในรูปที่ 3.17,3.18,3.19 ตามลำดับ



้ ก่าสูงสุดของการเกลื่อนตัวในแนว x คือ 10.041 nm





#### 3.5 การเปรียบเทียบผลของชั้นมวลที่ติดอยู่บนผิวของ QCM กับทฤษฎีของ Sauerbrey

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง การเปรียบเทียบระหว่างความถี่เรโซแนนซ์ที่คำนวณได้จาก โปรแกรม COMSOL กับความถี่เรโซแนนซ์ที่คำนวณได้จากสมการของ Sauerbrey เมื่อมีมวลซึ่งใน กรณีนี้คือทองมาเคลือบที่ผิวของ QCM อย่างสม่ำเสมอตลอดบริเวณอิเล็กโทรด

#### 3.5.1 สมการของ Sauerbrey

เมื่อมีมวลมาเกาะอย่างสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งผิวอิเล็กโทรดของ QCM จะส่งผลต่อความถึ ในการสั่นของ QCM โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงมวลที่มาเกาะที่ผิวของ QCM กับ ความถี่เร โซแนนซ์ ตามสมการที่ (3.19) ที่พิสูจน์โดย Sauerbrey [2]

$$\Delta f_s = -\frac{2f_0^2 \Delta m}{A\sqrt{\rho_q \mu_q}} \tag{3.19}$$

โดยที่

 $\Delta f_{,}$  คือ ความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลง [Hz]

 $f_0$  คือ ค่าความถี่เร โซแนนซ์ตั้งต้น [Hz]

 $\Delta m$  คือ มวลที่มายึดเกาะผิวของ QCM [kg]

A คือ พื้นที่ของอิเล็กโทรค  $[m^2]$ 

 $ho_{q}$  คือ ความหนาแน่นของ QCM (2648 kg/m<sup>3</sup>)

 $\mu_q$  คือ ค่าความเนื้อนของ QCM ( $c_{66}^E + e_{26}^2 / \varepsilon_{22}^S = 29.23618 \times 10^9 \, \mathrm{kg/m.s^2}$ )

การเคลือบมวลที่ผิว QCM ในที่นี้ได้เลือกใช้ทองเป็นวัสดุโดยมีความหนา L และเคลือบ เฉพาะบริเวณอิเล็กโทรคเท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 การเคลือบทองที่ผิวบนของ QCM หนา L เฉพาะบริเวณอิเล็ก โทรค

ดังนั้นมวลของทองที่อยู่บนผิวของ QCM (  $\Delta m$  ) สามารถแสดง ได้ดังสมการที่ (3.20)

$$\Delta m = \rho_g \Delta V = \rho_g LA \tag{3.20}$$

เมื่อ

 $ho_{g}$  คือ ความหนาแน่นของทอง (19300 kg/m³) ดังนั้นสมการที่ (3.19) สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (3.21)

$$\Delta f_s = -\frac{2f_0^2 \rho_g LA}{A\sqrt{\rho_q \mu_q}} = -\frac{2f_0^2 \times 19300L}{\sqrt{2648 \times 29.23618 \times 10^9}} = -0.004387 f_0^2 L \quad (3.21)$$

การวิเคราะห์ด้าน QCM ต้องมีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงการ สั่นทางกลเป็นวงจรทางไฟฟ้าโดยสามารถแสดงวงจรสมมูลทางไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 3.21 [17]

# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.21 วงจรสมมูลของQCM ก่อนและหลังมีมวลมาเกาะที่ผิวอิเล็กโทรค

โดยที่

Cp คือ ค่าความจุไฟฟ้าของอิเล็กโทรคที่ประกบอยู่ที่ทั้ง 2 ด้านของ QCM Rs คือ ค่าความต้านทาน แทน การสูญเสียพลังงานของ QCM ในขณะสั่น Ls คือ ตัวเหนี่ยวนำ Cs คือ ตัวเก็บประจุ

Lload คือ ตัวเหนี่ยวนำที่เกิดจากมวลมาเกาะที่ผิวของ QCM

จะเห็นว่าการใส่มวลมาเกาะที่ผิวของ QCM ผลกระทบก็คือการเพิ่มตัวเหนี่ยวนำ Lload เข้า มาในวงจรดังนั้นกราฟของแอดมิตแตนซ์จะมีลักษณะและขนาดเท่าเดิม เพียงแต่มีการเลื่อน กวามถี่เรโซแนนซ์ไปทางด้านซ้าย (ลดความถี่เรโซแนนซ์ลงดังแสดงในสมการที่ (3.22)) ซึ่งการ เปลี่ยนลักษณะของกราฟแอดมิตแตนซ์ของ QCM แสดงในรูปที่ 3.22

$$f_s \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_s}} \Rightarrow f_s \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_s + Lload)C_s}}$$
 (3.22)



รูปที่ 3.22 กราฟแอคมิตแตนซ์ของ QCM ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมี mass loading

#### 3.5.2 แบบจำลองของชั้นมวลในโปรแกรม COMSOL

สร้างแบบจำลองตามรูปที่ 3.23 โดยแปรค่าความหนา L แล้วดูค่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ คำนวณได้จากโปรแกรม COMSOL

กำหนดซับโดเมน 1,2,4 ให้เป็นควอตซ์แบบ AT-cut ใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 mm หนา 166.8 μm ใช้โหมดการคำนวณแบบ piezo plane stress และมีความหนาทางแกน z คือ 8 mm

กำหนดซับโดเมน 3 ให้เป็นชั้นทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่าอิเล็กโทรดคือ 5 mm หนา L ใช้โหมดการคำนวณแบบ plane stress ใส่ค่าคงที่วัสดุทองดังรูปที่ 3.24 คือใส่ค่าวัสดุ 3 ค่า ดังนี้ Young's modulus ( $E_g$ ) = 78×10<sup>9</sup> N/m<sup>2</sup>, Poisson's ratio ( $\nu_g$ ) =0.44, Density ( $\rho_g$ ) = 19300 kg/m<sup>3</sup> และมีความหนาทางแกน z คือ 8 mm



รูปที่ 3.23 แบบ<mark>จำลองของ QCM ที่มีชั้นทองหนา L</mark> เคลือบอยู่ที่ผิวอิเล็กโทรด

Ibdomains Groups	Material Constraint	Load Damping Initial Stress	and Strain PML Init Element Color
ubdomain selection	Material settings		
<u>~</u>	Library material:	V Load	]
	Material model:	Isotropic material 🐱	
	Coordinate system:	Global coordinate system 💙	
	Use mixed U-P f	ormulation (nearly incompressil	ole material)
	Quantity	Value/Expression	Description
	E PO O	78e9	Young's modulus
	v	0.44	Poisson's ratio
	1221		
roup:			
Select bu group	a		Thermal expansion coeff.
_ Select by group	ρ	19300	Density
Active in this domain	thickness	8e-3	Thickness
0			

รูปที่ 3.24 ค่าวัสคุของทองที่ใส่ในโปรแกรม COMSOL

การกำหนดเงื่อนไขทำในทำนองเดียวกับแบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ธรรมคา คือ เป็นดังรูปที่ 3.10 โดยมีการเชื่อมต่อเงื่อนไขขอบเขตคือการเคลื่อนตัวในแนวแกน x และแกน y (ตัว แปร u และ v) กับชั้นทองที่ผิวสัมผัสระหว่างควอตซ์กับทองเพิ่มขึ้นมา

การคำนวณใช้เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic ในทุกซับโคเมน แบ่งเอลิเมนต์เป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (map mesh) ที่ตัวควอตซ์ใช้เป็นแบบเคิมคือ แนวนอน×แนวตั้ง = 240×20 = 4800 เอ ลิเมนต์ และที่ชั้นทองเป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 150×1 = 150 เอลิเมนต์ (ซึ่งใช้เพียงแนวตั้ง 1 ชั้นที่ ชั้นทอง คำตอบก็มีการลู่เข้า เพราะชั้นทองมีความหนาน้อยมากเมื่อเทียบกับควอตซ์) รวมเอลิเมนต์ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดเป็น 4950 เอลิเมนต์

ความถี่เร โซแนนซ์ที่คำนวณได้จากโปรแกรม COMSOL พร้อมทั้งขนาดของแอดมิตแตนซ์ ที่ความถี่เร โซแนนซ์ เมื่อแปรค่าความหนาของทอง L แสดงดังตาราง 3.6

ความหนาของทอง 🥖	ความถี่เร โซแนนซ์	แอคมิตแตนซ์สูงสุด	$\Delta f_s = f_s - f_0 [Hz]$
L [A <sup>°</sup> ]	f <sub>s</sub> [Hz]	Y  <sub>max</sub> [S]	
0	9938476	5.28	0
417	9921219	5.32	-17257
834	9903839	5.31	-34637
1251	9886396	5.32	-52080
1668	9868927	5.34	-69549
4170	9764530	5.28	-173946
8340	9594829	5.29	-343647
12510	9432030	5.28	-506446
16680	9276507	5.28	-661969

ตาราง 3.6 ก่ากวามถี่เร โซแนนซ์ พร้อมทั้งก่าแอคมิตแตนซ์ ที่กวามหนาทอง L ก่าต่างๆ

เมื่อนำการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์ Δf, ที่คำนวณได้จากโปรแกรม COMSOL มา เปรียบเทียบกับ Δf, ที่คำนวณได้จากสมการที่ 3.21 ซึ่งเป็นผลที่ได้มาจากสมการของ Sauerbrey จะ ได้ผลดังตารางที่ 3.7 และเปรียบเทียบเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 3.25

ความหนาของทอง L[Aº]	$\Delta \mathrm{f_s}$ [Hz] COMSOL	$\Delta \mathrm{f}_{\mathrm{s}}$ [Hz] สมการที่ 3.21	
0	0	0	
417	-17257	-18069	
834	-34637	-36139	
1251	-52080	-54208	
1668	-69549	-72277	
4170	-173946	-180694	
8340	-343647	-361388	
12510	-506446	-542082	
16680	-661969	-722776	

ตารางที่ 3.7  $\Delta {
m f}_{
m s}$  ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL เทียบกับที่ได้จากสมการของ Sauerbrey ที่ความหนาของทอง L ต่างๆกัน



ที่ความหนาของทอง L ต่างๆกัน

จะเห็นได้ว่าที่ความหนาทอง L น้อยๆ (มวลของทอง  $\Delta_m$  น้อยๆ) ความถี่เรโซแนนซ์ที่ เปลี่ยนแปลง  $\Delta_{f_s}$  ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากสมการของ Sauerbrey

ส่วนที่ความหนาทอง L มากๆ (มวลของทอง  $\Delta m$  มากๆ) ความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลง  $\Delta f_{
m s}$  ที่ได้จากโปรแกรม COMSOL จะแตกต่างจากสมการของ Sauerbrey มาก ทั้งนี้เนื่องจากว่า สมการของ Sauerbrey นั้นมีข้อจำกัด [18] คือสามารถคำนวณได้เฉพาะที่การเปลี่ยนแปลงมวล  $\Delta m$  น้อยๆ เท่านั้น

การหากราฟแอคมิตแตนซ์ด้องใช้การสแกนความถี่ที่ห่างกันละเอียคถึง 1 Hz จึงจะใด้ ขนาดของแอคมิตแตนซ์สูงสุดใกล้เกียงกันที่ความหนาทอง L ต่างๆ กันตามตารางที่ 3.6 เนื่องจาก หากสแกนด้วยความถี่ที่ห่างกันละเอียดเพียง 10 Hz จะใด้ขนาดของแอคมิตแตนซ์ที่สูงสุดไม่ถึงค่าที่ ทำให้เกิดกวามถี่เรโซแนนซ์(≈5.3 S) คือ ที่ความหนาทอง L ต่างๆ กันจะได้ค่าขนาดของแอคมิต แตนซ์สูงสุดไม่ใกล้เกียงกัน เพราะความละเอียดในการสแกนไม่เพียงพอดังแสดงในตารางที่ 3.8

ความถี่ [Hz] ที่ทำให้	ขนาดแอคมิตแตนซ์สูงสุด
แอคมิตแตนซ์สูงสุด	[S]
9938480	3.50
9921220	5.09
9903840	5.21
9886400	3.49
9868930	3.89
	ความถี่ [Hz] ที่ทำให้ แอคมิตแตนซ์สูงสุด 9938480 9921220 9903840 9886400 9868930

ตารางที่ 3.8 ก่ากวามถี่ที่ทำให้เกิดก่างนาดของแอดมิตแตนซ์สูงสุด พร้อมทั้งก่าแอดมิตแตนซ์นั้น ที่กวามหนาทอง L ต่างๆ เมื่อสแกนด้วยกวามละเอียดเพียง 10 Hz

กราฟของขนาดแอคมิตแตนซ์ที่สแกนละเอียดพอจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เมื่อความหนา ทอง L ต่างๆกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือการเลื่อนตำแหน่งของความถี่เร โซแนนซ์ไปในทิศทางที่ต่ำลง เมื่อความหนามากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 กราฟขนาดของแอคมิตแตนซ์เมื่อเกิด mass loading ของชั้นทองที่ความหนา L ต่างๆกัน เมื่อสแกนละเอียดถึง 1 Hz

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# 3.5.3 แบบจำลองของชั้นมวล 2 ฝั่งในโปรแกรม COMSOL

หัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบความถี่เรโซแนนซ์ของ QCM ระหว่างการมีมวลที่เคลือบฝั่ง เดียว กับการมีมวลที่เคลือบทั้ง 2 ฝั่ง ดังแสดงในรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 รูปแบบการเคลือบมวลยูนิฟอร์ม 2 ฝั่งแบบต่างๆ

จากการคำนวณด้วยโปรแกรม COMSOL พบว่า ไม่ว่าเราจะทำการเคลือบมวลที่ผิวของ QCM เป็นแบบฝั่งเดียวหรือ 2 ฝั่ง ถ้าความหนาของมวลที่เคลือบมีค่าเท่ากันแล้ว ความถี่เรโซแนนซ์ ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.9 ซึ่งเป็นการแสดงว่าผลกระทบของ มวลที่มาเคลือบที่ผิวของ QCM มีผลต่อคลื่นเฉือนที่แพร่ไปในแนวความหนาของ QCM ทั้ง 2 ฝั่ง และทฤษฎีของ Sauerbrey ก็สามารถใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงมวลทั้ง 2 ฝั่งของ QCM

# จพาลงกรณมหาวทยาลย

# ตารางที่ 3.9 ก่ากวามถี่เร โซแนนซ์ที่กำนวณได้จาก COMSOL ที่กวามหนาของทองฝั่งเคียว และ 2 ฝั่งที่กวอตซ์หนา d = 166.8 μm

ความหนา [A°]	ความถี่เร โซแนนซ์f <sub>s</sub> (Hz)	แอคมิตแตนซ์สูงสุด (mho)
L=0	9938476	5.28
L=417	9921219	5.32
A=208.5 , B=208.5	9921219	5.31
C=417	9920367	5.29
D=208.5, E=208.5	9920366	5.30
L=834	9903839	5.31
A=417, B=417	9903837	5.28
L=1251	9886396	5.32
A=834, B=417	9886391	5.28



# การคำนวณเพื่อนำ QCM ไปประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงการใช้โปรแกรม COMSOL ในการวิเคราะห์ QCM เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์ โดยจะกล่าวถึง

- 1. ผลของรัศมีอิเล็กโทรคที่มีต่อความถี่เรโซแนนซ์
- 2. ผลของตำแหน่งต่างๆในการวางมวลลงบน QCM ที่มีต่อความถี่เร โซแนนซ์
- 3. ผลของการเปลี่ยนขนาดแรงคันไฟฟ้าที่มีต่อการสั่นของ QCM
- 4. ผลของการที่มีมวลมาเกาะแบบไม่สม่ำเสมอบน QCM ที่มีต่อความถี่เร โซแนนซ์

#### 4.1 ผลของขนาดรัศมีอิเล็กโทรดต่อความถื่เรโซแนนซ์

ได้สร้างแบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ใน 2 มิติ ตามหัวข้อที่ 3.2.2 โดยคงค่าความ หนาของควอตซ์ไว้ที่ 166.8 μm และผลึกควอตซ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm แต่แปรค่าของรัศมี อิเล็กโทรด r ที่เป็นระยะการป้อนแรงคันไฟฟ้า โดยละเลยความหนาของอิเล็กโทรด เพื่อดูความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แบบจำลองแสดงดังรูปที่ 4.1

ใช้เอถิเมนต์แบบ lagrange-quadratic แบ่งเอถิเมนต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (map mesh) แนวนอน×แนวตั้ง=240×20=4800 เอถิเมนต์ เหมือนแบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut หัวข้อที่ 3.2.2

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



โดยแปรค่ารัศมีอิเล็กโทรด r ในโปรแกรม COMSOL

ผลการคำนวณแสดงคังตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ความถี่เร โซแนนซ์ และแอคมิตแตนซ์สูงสุด ของควอตซ์แบบ AT-cut เมื่อมีรัศมีอิเล็ก โทรคต่างๆกัน

รัศมีอิเล็กโทรค r [mm]	ความถี่เร โซแนนซ์ f, [Hz]	แอคมิตแตนซ์สูงสุด [S]
0.5	9958158	0.42
1	9950028	1.51
1.5	9944385	2.79
9 2	9940751	4.04
2.5	9938476	5.28
3	9937168	6.32
3.5	9936603	7.18
4	9936502	7.50



รูปที่ 4.2 กราฟความถี่เร โซแนนซ์เมื่อแปรค่ารัศมีอิเล็ก โทรด r

จะเห็นได้ว่าเมื่อรัศมีอิเล็กโทรดหรือระยะการป้อนแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นความถี่เรโซแนนซ์ จะมีค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากความจำกัดของเส้นผ่านศูนย์กลางของผลึกควอตซ์ ดังนั้นถ้ารัศมี อิเล็กโทรดหรือระยะการป้อนแรงดันไฟฟ้าน้อยผลึกควอตซ์จะได้รับแรงดันไฟฟ้าอย่างเต็มที่และมี การสั่นที่เป็นอิสระมากเนื่องจากไกลจากขอบที่ถูกยึดไว้

ดังนั้นในการออกแบบผลึกควอตซ์ที่จะนำมาใช้เป็น QCM จึงควรออกแบบให้มีรัศมี อิเล็กโทรดที่น้อย เพื่อจะได้ทำให้ควอตซ์ที่ได้มีความถี่เรโซแนนซ์ที่สูงขึ้น เมื่อนำมาวัดมวลก็จะได้ ค่าการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์  $\Delta f_s$  ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสามารถแสดงได้จากสมการของ Sauerbrey (สมการที่ (3.19)) ที่มีค่าแปรผันโดยตรงกับ  $f_0^2$ 

#### 4.2 ผลของการเปลี่ยนบริเวณการเกาะของมวลต่อความถื่เรโซแนนซ์ของ QCM

ได้สร้างแบบจำลองวางทองขนาดกว้าง 0.5 mm (1 ใน 10 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด) หนา 417 A° ที่ตำแหน่ง 1 ถึง 9 บน QCM ซึ่งหนา 166.8 μm เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm และมีรัศมีอิเล็กโทรด 5 mm ตามรูปที่ 4.3 และลองใส่ทองที่มีขนาดเท่ากันคือกว้าง 5 mm (เท่าเส้น ผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรด) หนา 41.7 Am ตามรูปที่ 4.4 ความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงจะขึ้นกับ ตำแหน่งอย่างไร

ค่าวัสดุของทองมีดังนี้ Young's modulus  $(E_g) = 78 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ , Poisson's ratio  $(v_g) = 0.44$ , Density  $(\rho_g) = 19300 \text{ kg/m}^3$  และมีความหนาทางแกน z คือ 8 mm



รูปที่ 4.4 การวางทองแบบยูนิฟอ<mark>ร์มขนาดเท่าเส้นผ่</mark>านศูนย์กลางอิเล็ก โทรด และหนา 41.7 A°

การคำนวณใช้เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic โดยแบ่งเอลิเมนต์เป็นแบบสี่เหลี่ยม (map mesh) ที่ตัวควอตซ์เป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 240×20 = 4800 เอลิเมนต์ ส่วนทองที่ตำแหน่งต่างๆ เป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 15×1 = 15 เอลิเมนต์ รวมเอลิเมนต์ทั้งหมดเป็น 4815 เอลิเมนต์ ส่วนแบบจำลองที่เป็นแบบชั้นทองยูนิฟอร์มทั่วอิเล็กโทรด ใช้เอลิเมนต์ที่ชั้นทองเป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 150×1 = 150 เอลิเมนต์ รวมเอลิเมนต์ทั้งหมดเป็น 4950 เอลิเมนต์ ผลของความถี่เรโซแนนซ์เมื่อทำการเปลี่ยนบริเวณการเกาะของทองแสดงในตารางที่ 4.2

ตำแหน่ง	ความถี่เร โซแนนซ์	แอคมิตแตนซ์สูงสุด	$\Delta f_s[Hz]$
	f <sub>s</sub> [Hz]	$ \mathbf{Y} _{\max}[\mathbf{S}]$	
nolayer	9938476	5.28	0
1 หรือ 1'	9938457	5.29	-19
2 หรือ 2'	9938349	5.29	-127
3 หรือ 3'	9938087	5.28	-389
4 หรือ 4'	9937603	5.26	-873
5 หรือ 5'	9937013	5.27	-1463
6 หรือ 6'	9936472	5.28	-2004
7 หรือ 7'	9936084	5.21	-2392
8 หรือ 8'	9935895	5.24	-2581
9(ตรงกลาง)	9935872	5.20	-2604
ยูนิฟอร์มทั่วทั้ง	9936759	5.25	-1717
อิเล็กโทรด กว้าง 5			
mm หนา 41.7 Am	California Contraction	500 S	

ตารางที่ 4.2 ความถี่เร โซแนนซ์พร้อมทั้งก่าแอคมิตแตนซ์สูงสุด เมื่อใส่ทองที่ตำแหน่งต่างๆ บน OCM

จากผลที่ได้จะพบว่าถ้ามวลมาเกาะใกล้บริเวณตรงกลางควอตซ์ ความถี่เรโซแนนซ์จะมีการ เปลี่ยนแปลงมากกว่ากรณีเมื่อมวลเกาะห่างจากกึ่งกลางควอตซ์ นอกจากนี้จะพบว่าการที่มวลมา รวมกันอยู่เฉพาะตรงกลางอิเล็กโทรด จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์มากกว่าการ เปลี่ยนแปลงความถี่เรโซแนนซ์เมื่อมวลมีการกระจายอย่างยูนิฟอร์มทั่วทั้งผิวอิเล็กโทรด

ดังนั้นในการนำ QCM มาใช้เป็นไบโอเซนเซอร์ ในการจะวัดอะไรก็ตาม การตรึงมวลที่ผิว ของ QCM ควรจะตรึงที่ตรงกลางผิวของอิเล็กโทรด เพื่อจะได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงความถี่เร โซแนนซ์ที่วัดได้มีก่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หรือมีกวามไวในการวัดที่สูง

ส่วนในกรณีการทดลองจริง ที่มีการหยดสารปริมาณเท่ากันแต่การเปลี่ยนแปลงความถี่เร โซแนนซ์ที่ได้ไม่เท่ากัน ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้นั่นเอง เพราะในการทดลองจริงเราอาจหยด สารปริมาณเท่ากันแต่ไม่ตรงตำแหน่งเดียวกัน หรือมีการเอนเอียงจากบริเวณกึ่งกลางของ QCM ไป บ้าง หรือสารที่เราหยดไปรวมตัวอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นผลให้ความถี่เรโซแนนซ์ที่วัด ออกมามีก่าไม่เท่ากัน

#### 4.2.1 ความไวในการวัดความถี่เรโซแนนซ์ เมื่อมีมวลมาเกาะที่ตำแหน่งต่างๆบน QCM

ใด้จำลองรูปแบบที่เปลี่ยนความหนาของทองเป็น 2 เท่า และ 3 เท่า (834A° และ 1251A°) ของความหนาทองเดิม (417A°) ที่เกาะอยู่บนตำแหน่งต่างๆ 1 ถึง 9 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความถี่เร โซแนนซ์ และความไวในการวัด ณ ตำแหน่งต่างๆ บน QCM ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.3

ตำแหน่ง	หนา 417A <sup>°</sup>	หนา 834A°	หนา 1251A°
	$\Delta f_{s}[Hz]$	$\Delta f_{s}[Hz]$	$\Delta f_s[Hz]$
1 หรือ 1'	-19	-39	-61
2 หรือ 2'	-127	-277	-455
3 หรือ 3'	-389	-873	-1485
4 หรือ 4'	-873	-1989	-3374
5 หรือ 5'	-1463	-3290	-5843
6 หรือ 6'	-2004	-4412	-7262
7 หรือ 7'	-2392	-5212	-8289
8 หรือ 8'	-2581	-5611	-8799
9(ตรงกลาง)	-2604	-5661	-8863
ยูนิฟอร์มทั่ว 🦲	หนา 41.7Am	หนา 83.4Am	หนา 125.1Am
ทั้งอิเล็กโทรด	-1717	-3437	-5160

ตารางที่ 4.3 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปลี่ยนความหนาของทอง ที่มาเกาะบนตำแหน่งต่างๆที่ผิวของ QCM

กราฟแสดงความไวเมื่อมีมวลอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆบน QCM แสดงในรูปที่ 4.5 และรูปที่ 4.6 จากรูปจะเห็นได้ว่าความไวในการวัดหรือการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่เรโซแนนซ์จะได้ค่าสูงสุดเมื่อ มีมวลมาเกาะที่บริเวณตรงกลางของ QCM


รูปที่ 4.6 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เทียบกับตำแหน่งต่างๆบน QCM เมื่อเปลี่ยนความหนาของทอง

### 4.3 การเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นบน QCM เมื่อมีการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ QCM

ใด้สร้างแบบจำลองของควอตซ์แบบ AT-cut ใน 2 มิติ ตามหัวข้อที่ 3.2.2 โดยคงค่าความ หนาของควอตซ์ไว้ที่ 166.8 µm และผลึกควอตซ์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ขนาดอิเล็กโทรดหรือ ระยะการป้อนแรงดันไฟฟ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm ทำการแปรค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ อิเล็กโทรด Ø<sub>0</sub> [Vpeak] เป็น 5 ค่า คือ 1,2,3,4,5 Vpeak ดังรูปที่ 4.7 จากนั้นคำนวณหาการเคลื่อนตัว ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จุดกึ่งกลางผิวบนของควอตซ์

การคำนวณใช้เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic แบ่งเอลิเมนต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (map mesh) แนวนอน×แนวตั้ง=240×20=4800 เอลิเมนต์ เช่นเดียวกับแบบจำลองของควอตซ์แบบ ATcut หัวข้อที่ 3.2.2



ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.8

แรงคันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ	ความถี่เร โซแนนซ์	การเคลื่อนตัวรวมที่ตำแหน่ง
อิเล็กโทรด	f <sub>s</sub> [Hz]	กึ่งกลางบนผิวควอตซ์
$\phi_0$ [Vpeak]		[µm peak]
1	9938476	0.2049
2	9938476	2*0.2049
3	9938476	3*0.2049
4	9938476	4*0.2049
5	9938476	5*0.2049

ตารางที่ 4.4 ความถี่เร โซแนนซ์ และการเกลื่อนตัว ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของผิวบนของควอตซ์ แบบ AT-cut เมื่อเปลี่ยนค่าแรงคันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับอิเล็กโทรค



จากผลที่ได้ในตารางที่ 4.4 พบว่าขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ QCM ไม่มีผลทำให้ กวามถี่เรโซแนนซ์ในการสั่นของ QCM เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 4.8 พบว่าขนาด ของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนจะส่งผลกระทบต่อค่าการเคลื่อนตัวที่ปรากฎบนผิวของ QCM เป็นลักษณะ เชิงเส้น คือมีค่าการเคลื่อนตัวที่เพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ QCM เป็นไบโอเซนเซอร์จึงไม่ควรป้อนแรงคันไฟฟ้าให้กับ QCM มากเกินไปเพราะจะทำให้ QCM สั่นด้วยการเคลื่อนตัวที่สูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ โมเลกุลของสารที่ติดอยู่บนผิวของ QCM หลุดออกไปได้ หากแรงกระทำนี้สูงกว่าพันธะในการยึด โมเลกุลของสาร

### 4.4 ผลของการเกาะของมวลที่ไม่สม่ำเสมอต่อความถี่เรโซแนนซ์ของ QCM

เนื่องจากในการใช้งาน QCM ในการติดตามจำนวนเซลล์ เซลล์ที่เกาะบน QCM อาจจะเกาะ อย่างไม่สม่ำเสมอกล่าวคือ อาจมีการเกาะในบริเวณชั้นแรกเพียงเล็กน้อย จากนั้นเซลล์ที่ลงมาเกาะ ต่อในชั้นที่สองอาจจะขยายไปด้านข้างเรื่อยๆดังรูปที่ 4.9 เพื่อจำลองการเกาะของเซลล์ที่ไม่ สม่ำเสมอในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ในหัวข้อนี้ได้สร้างรูปแบบจำลองการเกาะของเซลล์ที่เป็นรูปตัว T ที่ตำแหน่งกึ่งกลางที่ผิวบนของ QCM ซึ่งหนา 166.8 μm เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm และมีรัศมี อิเล็กโทรด 5 mm ตามรูปที่ 4.10 แล้วศึกษาความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 4.9 โมเคลการเกาะของเซลล์เป็นรูปตัว T ที่ขยายออกไปทางค้านข้างเรื่อยๆ



รูปที่ 4.10 การใส่มวลเป็นรูปตัว T บน QCMใน 2 มิติ ในโปรแกรม COMSOL

มวลรูปตัว T ที่ใช้จะแบ่งเป็น 2 ชั้นคือชั้นฐาน กับชั้นบน แต่ละชั้นมีความหนา 834 A° โดย ชั้นฐานมีความกว้าง 2/30 mm (ซึ่งมีความกว้างเป็น 2 block ของ mesh ที่ใช้พอดี , mesh ที่ใช้มีขนาด กว้าง 1/30 mm) ส่วนชั้นบนมีการแปรขนาดกว้างตั้งแต่ A = 0 mm ถึง A = 1.4 mm ซึ่งตัวอย่างของ มวลรูปตัว T แสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 มวลรูปตัว T ที่นำมาเกาะบนผิวของ QCM

การคำนวณใช้เอลิเมนต์แบบ lagrange-quadratic แบ่งเอลิเมนต์เป็นแบบสี่เหลี่ยม (map mesh) ที่ตัวควอตซ์เป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 240×20 = 4800 เอลิเมนต์ ส่วนที่มวลรูปตัว T ที่ชั้น ฐานเป็น แนวนอน×แนวตั้ง = 2×1 = 2 เอลิเมนต์ และที่ชั้นบน Aใช้แนวตั้ง 1 ชั้น แต่แนวนอน แล้วแต่ความกว้างของชั้นบน ซึ่งแต่ละ mesh จะใช้ความกว้างที่แนวนอน 1/30 mm

มวลรูปตัว T ที่ใช้ เลือกใช้วัสดุ 2 อย่างเพื่อเปรียบเทียบกัน คือ ทอง กับโพลีสไตรีน

ทองมีค่าคงที่วัสคุดังนี้ Young's modulus  $(E_g) = 78 \times 10^9$  N/m<sup>2</sup>, Poisson's ratio  $(\nu_g) = 0.44$ , Density  $(\rho_g) = 19300$  kg/m<sup>3</sup> และมีความหนาทางแกน z คือ 8 mm

โพลีสไตรีนมีค่าคงที่วัสดุดังนี้ Young's modulus ( $E_p$ ) = 3.17×10<sup>9</sup> N/m<sup>2</sup>, Poisson's ratio ( $v_p$ ) =0.35, Density ( $\rho_p$ ) = 1050 kg/m<sup>3</sup> และมีความหนาทางแกน z คือ 8 mm

ตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.12 แสดงค่าความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ทองเป็น วัสคุมวลรูปตัว T ขนาดต่างๆกัน ส่วนตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.13 แสดงก่าความถี่เรโซแนนซ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้โพลีสไตรีนเป็นวัสคุมวลรูปตัว T ขนาดต่างๆกัน

ในกรณีที่มวถมีค่าคงที่ทางวัสคุคล้ายทองจากความถี่เรโซแนนซ์ที่ได้ในรูปที่ 4.12 ตอน แรกที่มวถเริ่มเกาะความถี่เรโซแนนซ์จะลดลง จนเมื่อขณะมวถเริ่มเกาะออกมาด้านข้างเป็นรูปตัว T ค่าความถี่ที่ได้จะมีลักษณะไม่คงที่ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแต่ละช่วงกลุ่มก็จะพบแนวโน้มที่ ค่าความถี่เรโซแนนซ์จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมวลในชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้น

ส่วนกรณีที่มวลมีค่าวัสดุคล้ายโพลีสไตรีน จากความถี่ที่ได้ในรูปที่ 4.13 ความถี่เรโซแนนซ์ จะลดลงเมื่อมวลเกาะมากขึ้น ถ้าการเกาะของมวลยังมีระยะอยู่ภายใน 1.4 mm ซึ่งเป็นระยะของชั้น บนของตัว T ที่มากที่สุดที่ใช้ในการคำนวณ

ความกว้างของแผ่นชั้นบน	จำนวน blocks ของ mesh	$\Delta \mathrm{f}_{\mathrm{s}}[\mathrm{Hz}]$
A [mm]		
0	0	-596
2/30(ความกว้างเท่าชั้นฐาน)	2	-1072
4/30	4	-1583
0.2	6	-109
8/30	8	-1056
10/30	10	-1552
0.4	12	4
14/30	14	-1040
16/30	16	-1524
0.6	18	141
20/30	20	-1024
22/30	22	-1496
0.8	24	306
26/30	26	-1008
28/30	28	-1471
1	30	510
32/30	32	-991
34/30	34	-1447
1.2	36	767
38/30	38	974
40/30	40	-1424
9 1.4	42	1098

ตารางที่ 4.5 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้**ทอง**เป็นวัสคุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM

ความกว้างของแผ่นชั้นบน	จำนวน blocks ของ mesh	$\Delta \mathrm{f_s}[\mathrm{Hz}]$
A [mm]		
0	0	-35
2/30(ความกว้างเท่าชั้นฐาน)	2	-68
4/30	4	-102
0.2	6	-136
8/30	8	-170
10/30	10	-203
0.4	12	-236
14/30	14	-269
16/30	16	-302
0.6	18	-334
20/30	20	-366
22/30	22	-398
0.8	24	-429
26/30	26	-460
28/30	28	-491
1 🤳	30	-521
32/30	32	-551
34/30	34	-580
1.2	36	-609
38/30	38	-638
9 40/30	40	-667
1.4	42	-695

## ตารางที่ 4.6 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ **โพลีสไตรีน** เป็นวัสคุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างของชั้นบน A ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM





รูปที่ 4.14 กราฟแสดงค่าการเคลื่อนตัวทางแกน x ที่ชั้นบนของทองรูปตัว T เทียบกับแกน x ที่ความถี่เร โซแนนซ์ เมื่อความกว้างของชั้นบนของตัว T ,A = 1.4 mm(42 blocks)



รูปที่ 4.15 กราฟแสดงค่าการเคลื่อนตัวทางแกน x ที่ชั้นบนของ**โพลีสไตรีน** รูปตัว T เทียบกับแกน x ที่ความถี่เร โซแนนซ์ เมื่อความกว้างของชั้นบนของตัว T ,A = 1.4 mm(42 blocks)

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนตัวในแนว แกน x ที่ชั้นบนของรูปตัว T ที่ความถี่เรโซแนนซ์ซึ่ง แสดงในรูปที่ 4.14 และ 4.15 จากรูปจะเห็นว่าถ้ามวลเป็นทองจะมีการส่ายเป็นรูปคลื่นซายน์ ส่วน กรณีของมวลเป็นโพลีสไตรีนจะไม่มีการส่ายเป็นรูปคลื่นซายน์ (หรือสั่นเป็นรูปคลื่นซายน์ไม่ถึง 1 ลูก) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทองมีการเคลื่อนตัวที่สูงกว่าโพลีสไตรีนราว 4 เท่า คาดว่าเนื่องจากทอง มีความหนาแน่นและค่ายังส์โมดูลัสที่สูงกว่าโพลีสไตรีน



### บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอแบบจำลองของ QCM ใน 2 มิติโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ COMSOL โดยในขั้นแรกได้ทำการเปรียบเทียบกับทฤษฎีเบื้องต้นและงานวิจัยที่มีมาในอดีตซึ่ง ได้ผลสอดกล้องกันคือ

- 1. ความถี่เร โซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cut แปรผกผันกับความหนาของควอตซ์
- 2. ที่ความถี่เรโซแนนซ์ควอตซ์แบบ AT-cut จะสั่นแบบ thickness shear mode
- 3. การสั่นเป็นแบบครึ่งคลื่นที่ความถี่ฮาร์ โมนิกคี่ของควอตซ์แบบ AT-cut
- การเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่เร โซแนนซ์เป็นไปตามสมการของ Sauerbrey คือ ความถี่เร โซแนนซ์จะลดลงแบบเชิงเส้นเมื่อมีมวลมาเกาะอย่างยูนิฟอร์มที่อิเล็กโทรด นอกจากนี้ได้สร้างรูปแบบจำลองเพื่ออธิบายตัวแปรต่างๆซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้

 เมื่อทำการเพิ่มรัสมีอิเล็กโทรดพบว่าความถี่เรโซแนนซ์ของควอตซ์แบบ AT-cut จะมีค่า ลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากความจำกัดของเส้นผ่านสูนย์ของควอตซ์ทำให้การสั่นของควอตซ์ไม่เป็น อิสระเมื่อมีระยะการป้อนแรงคันไฟฟ้าที่มากขึ้น ดังนั้นในการออกแบบควอตซ์แบบ AT-cut ที่จะ นำมาทำเป็น QCM จึงควรออกแบบให้มีรัสมีอิเล็กโทรดที่น้อย เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เร โซแนนซ์ที่มาก เพื่อจะได้ความไวในการวัดมวลที่สูงตามสมการของ Sauerbrey

2. เมื่อทำการเปลี่ยนบริเวณการเกาะของมวล พบว่าความถี่เรโซแนนซ์จะมีค่าเปลี่ยนแปลง มากเมื่อตำแหน่งของการเกาะเป็นบริเวณตรงกลางอิเล็กโทรด และความถี่เรโซแนนซ์มีค่า เปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อมวลเกาะที่ตำแหน่งห่างจากกึ่งกลางอิเล็กโทรด นอกจากนี้พบว่าการเคลือบ มวลปริมาณที่เท่ากันแบบยูนิฟอร์มทั่วทั้งผิวอิเล็กโทรด จะทำให้ความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลง ใปมีค่าน้อยกว่าการทำให้มวลรวมตัวกันอยู่บริเวณกลางอิเล็กโทรด ดังนั้นในการนำ QCM ไปทำ การวัดด้านไบโอเซนเซอร์จึงควรพยายามหยดมวลที่ตรงกลางอิเล็กโทรด ไห้มากที่สุด เพื่อให้ได้ ความไวในการวัดที่สูง และควรทำการกวบคุมบริเวณกรหยดของมวลให้อยู่บริเวณตรงกลาง เนื่องจากบริเวณการหยดมวลที่ต่างกันขณะที่มวลที่หยดเท่ากัน จะทำให้ความถี่เรโซแนนซ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปต่างกันด้วย จึงควรควบคุมการหยดมวลให้เป็นบริเวณเดียวกันเพื่อควบคุมคุณภาพ ในการวัด

เมื่อทำการเปลี่ยนแรงคันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ QCM พบว่าถ้าแรงคันไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น
 เป็นเชิงเส้น ค่าการเคลื่อนตัวที่ผิวของ QCM ที่ความถี่เดียวกันจะมากขึ้นเป็นเชิงเส้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามขนาดของแรงคันไฟฟ้าจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก่ากวามถี่เรโซแนนซ์ ดังนั้น การนำ QCM มาใช้งานด้านไบโอเซนเซอร์จึงไม่ควรป้อนแรงคันไฟฟ้าที่มากเกินไป เนื่องจากจะทำ ให้เกิดการเกลื่อนตัวที่ผิวของ QCM มีก่าต่ำ ทำให้โมเลกุลที่เกาะที่ผิวของ QCM ไม่เกิดการหลุด ออกจากผิว

4. กรณีที่มวลมาเกาะที่ผิวของ QCM ชั้นแรกมีเพียงเล็กน้อย แล้วชั้นต่อมามีการเกาะมาก ออกไปทางด้านข้างหรือเป็นลักษณะรูปตัว T ถ้ามวลมีค่าทางวัสดุใกล้เคียงกับทองความถี่ที่วัดได้ ในตอนแรกจะมีค่าลดลงก่อนจากนั้นจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนกรณีที่มวลมีค่าวัสดุคล้ายโพลีสไต รีนความถึ่จะมีค่าลดลงตามมวลที่เกาะ (ในระยะ 1.4 mm ที่ทำการคำนวณ) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้าวัสดุที่มาเกาะบน QCM เป็นวัสดุที่ต่างชนิดกัน ความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีลักษณะ ต่างกันด้วย และความถี่เรโซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกาะของวัสดุนั้น

### 5.2 ปัญหาและข้อเสนอ<mark>แนะ</mark>

ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 แบบจำลองที่ทำได้เป็นเพียง 2 มิติ เนื่องจากการทำเป็นรูปทรง 3 มิติ จะใช้หน่วยความจำ มากเกินไปจนไม่สามารถทำการคำนวณได้ สำหรับหน่วยความจำที่มีอยู่จะแบ่ง mesh 3 มิติได้ไม่ ละเอียดพอ ทำให้คำตอบที่คำนวณได้ไม่ดีพอ ดังนั้นอาจต้องเพิ่มหน่วยความจำหรือ CPU ของ กอมพิวเตอร์ หรือต้องหาวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการแก้สมการที่สามารถจำลองรูปทรง 3 มิติ ได้โดยใช้หน่วยความจำน้อยลง

2. แบบจำลองที่ชั้นมวลเป็นของเหลว ต้องใช้สมการ Navier-Stokes ในการจำลองชั้น ของเหลว ซึ่งในโปรแกรม COMSOL ไม่มีโหมดของ Navier-Stokes ที่เป็น frequency response จึง ทำการเชื่อมต่อระหว่างควอตซ์กับชั้นของเหลวไม่ได้ ดังนั้นที่ชั้นของเหลวได้ทำการสร้างระบบ สมการ PDE ที่เป็นสมการ Navier-Stokes ในรูปแบบของ frequency response ขึ้นมาแทน แต่ถึงแม้ จะได้กราฟขนาดของแอดมิตแตนซ์เลื่อนไปทางซ้ายและมีขนาดลดลง แต่ความถี่ที่ลดลงยังไม่ตรง ตามสมการของ Kanazawa และ Gordon ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนนี้ต่อไป

 ในการทดลองจริงของ QCM เช่นในบางการทดลองพบว่าการวัดเซลล์มีความถี่เร โซแนนซ์ที่เพิ่มขึ้นไปในทางเดียว ซึ่งยังไม่สามารถหาแบบจำลองในโปรแกรม COMSOL ที่ สามารถอธิบายความถี่เรโซแนนซ์เพิ่มขึ้นไปในทางเดียวได้ ซึ่งต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป

#### รายการอ้างอิง

- [1] Der Ho Wu, Yng Jyi Tsai, Yu Tang Yen, Robust Design Crystal Microbalance Using Finite Element and Taguchi Method, <u>Sensor and Actuator B</u>, 92, 3, (2003): 337-344.
- [2] Der Ho Wu, Wen Tung Chien, Yug Jyi Tsai, An Efficient Piezoelectric Analysis for Quartz Crystal Nanobalance Gas Sensor, <u>Sensor & Transducer Magazine</u>, 40, 2 (2004): 137-144.
- [3] C.Kurosawa, S.Kurosawa, H.Aizawa, T.Horibe, Computational Simulation of Vibration Displacement on Piezoelectric Quartz Crystal Using Finite Element Method, <u>IEEE</u> <u>UFFC</u> (2004): 554-557.
- [4] F.Lu, H.P.Lee, P.Lu, S.P.Lim, Finite Element Analysis of Interference for The Laterally Coupled Quartz Crystal Microbalances, <u>Sensor and Actuator A</u>, 119, 1, (2005):90-99.
- [5] V.M.Ristic, Principles of Acoustic Devices, (1983).
- [6] V.Piefort, A.Preumont, <u>Finite Element Modeling of Piezoelectric Structure</u>, (2001).
- [7] John R.Vig, <u>Quartz Crystal Resonators and Oscillators, For Frequency Control and</u> <u>Timing Applications-A Tutorial</u>, (2005).
- [8] Andi Asiz, Weiping Zhang, Yunping Xi, Analysis of Aging of Piezoelectric Crystal Resonators, <u>IEEE Transactions on Ultrasonics</u>, Ferroelectrics, and Frequency <u>Control</u>, 50, 12, (2003): 1647-1655.
- [9] Tapani Makkonen, Julius Koskela, Martti M. Salomaa, Two-Dimensional FEM Model for Crystal Resonators, <u>IEEE Ultrasonics Symposium</u>, 2, (1997): 951-954.
- [10] W.Cao, S.Zhu, B.Jiang, Analysis of Shear Modes in a Piezoelectric Vibrator, <u>Journal</u> <u>of Applied Physics</u>, 83, 8, (1998): 4415-4420.
- [11] Manfred Kaltenbacher, <u>Numerical Simulation of Mechatronic Sensors and</u> <u>Actuators</u>, Springer, (2003).
- [12] ปราโมทย์ เดชะอำไพ, สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช, <u>ไฟในต์เอลิเมนต์อย่างง่าย พร้อมซอฟต์แวร์</u>
   , สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2005).

- [13] D. D. Ebenezer, R. Ramesh, Exact analysis of Axially Polarized Piezoelectric Ceramic Cylinders with Certain Uniform Boundary Conditions, <u>Current Science</u>, 85, 8, (2003): 1173-1179.
- [14] K. Keiji Kanazawa, Mechanical Behaviour of Films on the Quartz Microbalance, <u>Faraday Discuss</u>, 107, 77, (1997) : 77-90.
- [15] H. Sun, P. Lu, P.Zhang, H. Chen, Dynamic Analysis of AT-Cut Quartz Resonators with ANSYS, Sensors, <u>Proceedings of IEEE</u>, 1,(2004): 95-98.
- [16] J. Kuntner, B. Jakoby, Two-Dimensional FEM Analysis of Pressure Wave Generation Mechanisms in TSM Liquid Sensors, Sensors, Proceedings of IEEE, 1, (2004):83-86.
- [17] Stephen J. Martin, Victoria Edwards Granstaff, Gregory C.Frye, Characterization of a Quartz Crystal Microbalance with Simultaneous Mass and Liquid Loading, <u>Analytical Chemistry</u>, 63, 20, (1991): 2272-2281.
- [18] S. Sherrit, V. Olazabal, J. M. Sansinena, X. Bao, Z. Chang, Y. Barcohen, Use of Piezoelectric Resonators for the Characterization of Mechanical Properties of Polymers, <u>Proceeding of SPIE Smart Structure Conference</u>, 4695, 35, (2002): 262-276.

## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

#### ภาคผนวก ก

### โปรแรม COMSOL

โปรแกรมที่ใช้เป็นโปรแกรม COMSOL 3.3 ซึ่งเป็นโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป มี กวามสามารถในการกำนวณแบบ Multiphysics คือสามารถกำนวณปัญหาที่เกิดจากหลักการทางฟิสิกส์ที่ แตกต่างกันหลายๆหลักการไปในขณะเดียวกัน จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่นการกำนวณ ในโหมดเพียโซอิเล็กทริกระนาบกวามเก้น ไปพร้อมๆกับการกำนวณในโหมดระนาบกวามเก้น การ กำนวณทางด้านไฟฟ้าไปพร้อมๆกับการกำนวณกวามร้อนที่เกิดขึ้น เป็นต้น กอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มี CPU 1.5 GHz RAM 2 GB



#### ภาคผนวก ข

## การตรวจสอบการสั่นของความถี่เรโซแนนซ์ที่คำนวณได้ เมื่อใช้ทองเป็นวัสดุมวลรูปตัว T

ความถี่เรโซแนนซ์ที่คำนวณใด้เมื่อใช้ทองเป็นวัสคุมวลรูปตัว T มีลักษณะสั่นอย่างไม่ สม่ำเสมอเมื่อมีมวลมาเกาะออกไปทางด้านข้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 4.5 และกราฟใน รูปที่ 4.12 ในขณะที่เมื่อใช้โพลีสไตรีนเป็นวัสดุของมวลรูปตัว T จะไม่เกิดการสั่นของความถี่เร โซแนนซ์ขึ้นดังแสดงในตารางที่ 4.6 และกราฟในรูปที่ 4.13

การสั่นของความถี่เร โซแนนซ์เมื่อใช้ทองเป็นวัสคุรูปตัว T อาจเกิดจากความผิดพลาดใน การคำนวณจากโปรแกรมไฟในต์เอลิเมนต์ ซึ่งสาเหตุของการสั่นของความถี่เร โซแนนซ์อาจเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

 เกิดจากค่าวัสดุของทองที่มากเกินไป คือ ค่ายังส์โมดูลัส (E) ของทอง (78e9 N/m<sup>2</sup>) ที่ มากกว่าของโพลีสไตรีน (3.17e9 N/m<sup>2</sup>) ถึง 25 เท่า และค่าความหนาแน่น (ρ) ของทอง (19300 kg/m<sup>3</sup>) ที่มากกว่าโพลีสไตรีน (1050 kg/m<sup>3</sup>) ถึง 18 เท่า

 2. ค่าอัตราส่วนของแนวนอนต่อแนวตั้งของเอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมของทองที่มากถึง <sup>1/30mm</sup>/<sub>834A<sup>0</sup></sub> ≈ 400 เท่า

จึงได้ทำการตรวจสอบกำตอบของความถี่เร โซแนนซ์ที่มีการสั่นอย่างไม่สม่ำเสมอโดย

 1. สลับเปลี่ยนค่าวัสดุยังส์โมดูลัส (E) ของทองกับโพลีสไตรีน หรือ สลับเปลี่ยนค่าวัสดุ ความหนาแน่น (ρ) ของทองกับโพลีสไตรีน เกิดเป็นค่าวัสดุตัวใหม่ เพื่อศึกษาว่าความถี่เรโซแนนซ์ มีการสั่นอย่างไม่สม่ำเสมอนั้นเป็นผลของค่ายังส์โมดูลัสหรือค่าความหนาแน่นที่สูงของทอง หรือไม่

 2. ทำการลดค่าอัตราส่วนของแนวนอนต่อแนวตั้งของเอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมของทองลง เหลือ <sup>1/30mm</sup>/<sub>8340A<sup>0</sup></sub> ≈ 40 เท่า

จากตารางที่ ข1 และกราฟในรูปที่ ข1 และ ข2 จะเห็นได้ว่าถ้าวัสดุรูปตัว T มีค่าวัสดุของ ทองตัวใดตัวหนึ่งอยู่ ถึงแม้ค่าวัสดุที่เหลือจะเป็นของโพลีสไตรีน ก็ยังจะทำให้เกิดการสั่นของ กวามถี่เร โซแนนซ์ที่เช่นเดิม ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าก่ายังส์โมดูลัส (E) หรือก่ากวามหนาแน่น (**p**) ที่ทำให้เกิดการสั่นของกวามถี่เร โซแนนซ์

ความกว้างของ	ทอง	โพลีสไตรีน		
แผ่นชั้นบน	E=78e9	E=3.17e9	E=78e9	E=3.17e9
A[mm]	<b>V</b> =0.44	V=0.35	V=0.44	V=0.44
	ρ=19300	ρ=1050	ρ=1050	ρ=19300
0	-596	-35	-35	-596
2/30	-1072	-68	-69	-1072
4/30	-1583	-102	-105	-1221
0.2	-109	-136	-144	-1021
8/30	-1056	-170	-195	-1097
10/30	-1552	-203	-273	-1662
0.4	4	-236	-431	-1049
14/30	-1040	-269	-1054	-1120
16/30	-15 <mark>2</mark> 4	-302	1245	-846
0.6	141	-334	327	-1068
20/30	-1024	-366	145	-1156
22/30	-1496	-398	61	-989
0.8	306	-429	7	-1085
26/30	-1008	-460	-33	-1253
28/30	-1471	-491	-69	-1032
1	510	-521	-104	-1104
32/30	-991	-551	-144	<b>2</b> 728
34/30	-1447	-580	-194	-1056
1.2 9	767	-609	-272	-1129
38/30	-974	-638	-428	-921
40/30	-1424	-667	-1039	-1074
1.4	1098	-695	1265	-1175

ตารางที่ ข1 ก่ากวามถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ก่าวัสดุต่างๆเป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่กวามกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน มาเกาะตรงกลาง QCM

หมายเหตุ : ค่าความถี่เร โซแนนซ์ของ QCM เมื่อไม่มีมวลมาเกาะมีค่า 9938476 Hz



รูปที่ ข1 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้วัสดุที่มีค่า E=78e9 N/m<sup>2</sup>,V=0.44 , $\rho$ =1050 kg/m<sup>3</sup> มาเป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน



รูปที่ ข2 กราฟกวามถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้วัสดุที่มีก่า E=3.17e9 N/m<sup>2</sup>,V=0.44 , $\rho$ =19300 kg/m<sup>3</sup> มาเป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่กวามกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน

ดวานอ้างของแย่งเช้นแบ	ແຕ່ລະຕັ້ນພລາທລາາມາ 224 A <sup>0</sup>	ູ່ ແຫລະ ອັນທຸລານລານມາ 2240 A <sup>0</sup>	
11111111110010000000000000000000000000	แต่แอบนบองทองทน 1854A	แทถะขนของทองทน 18340A	
A[mm]			
0	-596	-2131	
2/30	-1072	-2278	
4/30	-1583	-2367	
0.2	-109	-1393	
8/30	-1056	-2274	
10/30	-1552	-2364	
0.4	4	-949	
14/30	-1040	-2271	
16/30	-1524	-2360	
0.6	141	-108	
20/30	-1024	-2266	
22/30	-1496	-2356	
0.8	306	1094	
26/30	-1008	-2264	
28/30	-1471	-2352	
1	510	2710	
32/30	-991	-2257	
34/30	-1447	-2349	
1.2	767	4380	
38/30	-974	-2248	
40/30	-1424	-2345	
9 1.4	1098	6343	

ตารางที่ ข2 ค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ทองเป็นวัสคุมวลรูปตัว T เมื่อแต่ละชั้น ของทองหนา 834 A<sup>0</sup> และ 8340 A<sup>0</sup> ที่ความกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน

หมายเหตุ : ค่าความถี่เร โซแนนซ์ของ QCM เมื่อไม่มีมวลมาเกาะมีค่า 9938476 Hz



รูปที่ ข3 กราฟความถี่เร โซแนนซ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช้ทองที่แต่ละชั้นหนา 8340 A<sup>0</sup> เป็นวัสดุมวลรูปตัว T ที่ความกว้างชั้นบน A (รูปที่ 4.11) ต่างๆกัน

จากตารางที่ ข2 และกราฟรูปที่ ข3 จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการลดค่าอัตราส่วนของแนวนอนต่อ แนวตั้งของเอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมของทองลงเหลือ  $\frac{1/30mm}{8340A^0} \approx 40$  เท่า ยังคงมีการสั่นของความถี่เร โซแนนซ์เช่นเดิม จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการสั่นที่ไม่สม่ำเสมอของความถี่เร โซแนนซ์เกิดจากค่า อัตราส่วนของแนวนอนต่อแนวตั้งของเอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมของทอง

การสั่นของค่าความถี่เร โซแนนซ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลของ

- ค่ายังส์โมดูลัส หรือค่าความหนาแน่นที่สูงของทอง
- 2. ค่าวัสดุที่สูงนี้ส่งผลในกระบวนการคำนวณทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายณัฐจักษ์ สิริบันลือวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2546 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา มหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2547

